平成 29 年度
特許審査の質についての
ユーザー評価調査報告書

平 成 30 年 2 月

特　　　許　　　庁

要約

Ｉ．はじめに

国際的に信頼される質の高い審査及び適切な権利設定が、企業の円滑かつグローバルな事業展開を支援し､イノベーションの促進や健全な取引維持を図る上で重要です｡そして、質の高い特許権を設定するには、特許審査において、ユーザー（出願人や権利を行使される第三者等）のニーズや期待を適切に把握した上で、特許審査[1]の質の維持・向上に取り組んでいくことが重要です。

このような認識のもと、特許庁は、世界最高品質の特許審査の実現に取り組むための品質管理の基本原則を示した「特許審査に関する品質ポリシー」（以下、「品質ポリシー」といいます。）を公表しました。当該品質ポリシーでは、品質管理の 6 つの基本原則の 1 つに､「幅広いニーズや期待に応えます」と掲げております。

また、特許審査の品質検証のための取組を着実に実施するためには、ユーザーの声を真摯に受け止めることが重要です。そのため、特許庁は、平成 24 年度よりユーザー評価調査を実施し、調査結果の品質管理施策への反映に努めています。平成 29 年度の調査では、ユーザーが日本国特許庁の先行技術調査結果を外国庁と比較した場合にどのように評価しているかを検証するため、外国庁でより適切な引用文献が提示された頻度を問う設問を追加しました。

本調査結果は、多くのユーザーの協力の下に得られた貴重な情報であることから、特許庁は、本調査結果に基づいて、審査の質の維持・向上に向けて、引き続き真摯に取り組んでまいります。

以下、本調査結果の概要とともに、回答内容を詳細に分析した結果及びこれらを総合して得られた知見について報告をします。

Ⅱ．集計結果と詳細分析の概要

以下の 4 種類の調査票を用いてユーザー評価を調査しました（各調査票については、付録欄の第 40 頁以降を参照｡）。

A 票 ： 国内出願における特許審査の質全般について

B 票 ： 特定の国内出願における特許審査の質について

C 票 ： PCT 出願における国際調査等の質全般について

D 票 ： 特定の PCT 出願における国際調査等の質について

[1] 本報告書では､品質ポリシーにおける｢特許審査｣と同様､発明の審査（PCT出願に関する国際調査及び予備審査を含む）及び実用新案技術評価書の作成を意味します｡但し､国内出願における特許審査について説明する箇所では､国内出願の発明の審査を意味します｡

1. 質全般に関する評価及び分析
① 国内出願における特許審査の質全般について

最近（1 年程度）の特許審査の質全般について、「満足」または「比較的満足」の肯定的な回答の割合は、平成 24 年度の調査開始時から年々増加し、平成 29 年度は 58. 3%でした。

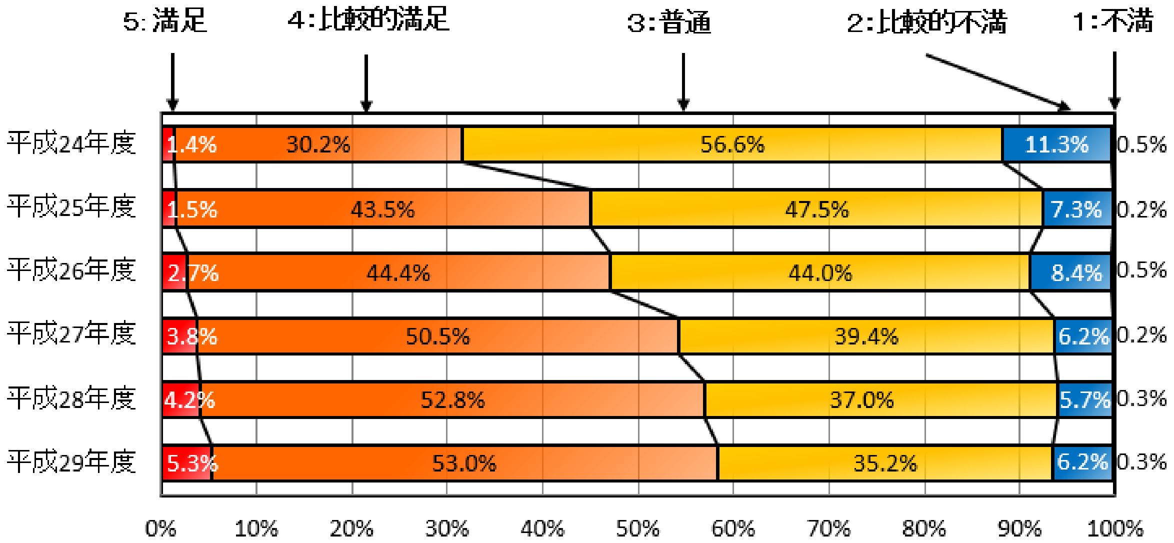

図 1：国内出願における特許審査の質全般についての満足度

本年度の「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」等の特許審査に関する設問について、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が 60%以上を占める、高評価の項目は、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」（67. 3%）、「国内特許文献の調査」（65. 7%）、「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション」（62. 1%）でした。この中でも特に、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」の項目では、「満足」又は「比較的満足」の割合が、平成 24 年の調査開始時から、30%以上向上していました。

また、「第 29 条 2 項（進歩性）」と、「第 36 条 4 項 1 号、第 36 条 6 項（明細書・特許請求の範囲の記載要件）」の設問において、平成 29 年度は、「比較的不満」又は「不満」の否定的な回答の割合がそれぞれ、14. 8%、13. 8%となり、昨年度に引き続き 20%以下となるとともに、平成 24 年度の調査開始以来、初めて、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が 40%を超えました。「判断の均質性について」の項目では、依然として「比較的不満」又は「不満」と回答した割合が 20%以上を占めていたものの、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合は、着実な改善傾向が見受けられました。

そして、「外国特許文献の調査」、「非特許文献等の調査」の項目では、昨年度から「満足」又は「比較的満足」の割合がそれぞれ約 7%、約 6%向上していました。

② PCT 出願における国際調査等の質全般について

最近（1 年程度）の国際調査等の質全般について、「満足」または「比較的満足」と回答した割合は、本年度初めて 50%を超え、54. 2%でした。この回答割合は、昨年度（48. 4%）から約 6%増加していました。

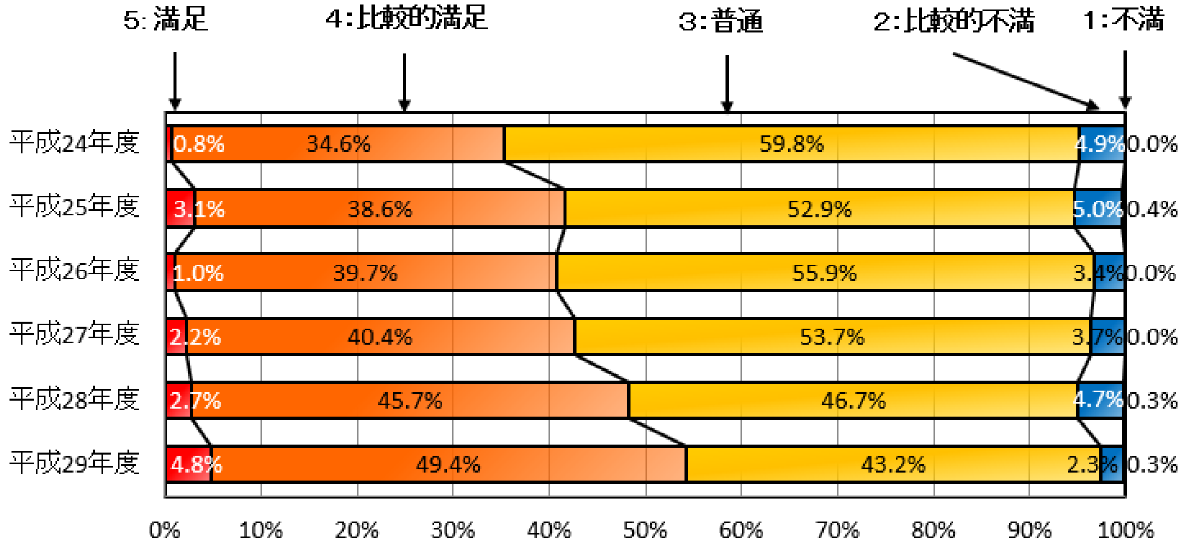

図 2：PCT 出願における国際調査等の質全般についての満足度

本年度の「国際特許分類の精度」等の国際調査等の質に関する設問について、「国内特許文献の調査」（65. 5%）、「国際特許分類の精度」（53. 3%）、「新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさ」（51. 2%）の 3 項目は、「満足」～「不満」のうち、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が 50%以上を占めていました。

また、「満足」～「不満」のうち、「不満」又は「比較的不満」と回答した割合が 10%を上回っていた項目は、「非特許文献等の調査」（18. 6%）、「外国特許文献の調査」（18. 5%）、「国際段階と国内段階との間での判断の一貫性」（14. 4%）の 3 項目でした。

「外国特許文献の調査」の項目について、否定的な回答の割合には昨年度からの大きな変化は見受けられなかったものの、肯定的な回答の割合が昨年度の 15. 9%から 26. 1%にまで改善していました。また、「国際段階と国内段階との間での判断の一貫性」の項目については、肯定的な回答の割合が昨年度の 35. 3%から 42. 3%にまで改善するとともに、否定的な回答の割合も平成 24 年度の調査開始より減少傾向が見られました。

③ 各評価項目の全体評価への影響

（1）国内：各評価項目の評価及び全体評価との相関

この節では、個別項目（「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」等）の評価が、質全般への評価（全体評価）に与える影響について調査しました。この影響の強さは、全体評価（特許審査の質全般に対する 5 段階評価、5：満足～1：不満）と、個別の項目への評価（項目別の 5 段階評価、5：満足～1：不満）との間の相関係数で分析することができます。

図 3 は、国内出願全般について（A 票）、個別項目の評価の平均と相関係数との関係を示したものです。図中、特に、現在の評価が低く、全体評価との相関係数が大きいほど（図中の左上側に位置する項目）、優先的に改善・向上を図ることが有益だと考えられます。

全 15 項目のうち、「判断の均質性」は、全体との相関が高く、評価の平均も各項目の評価の中で相対的に低いため、優先的に改善に取り組む必要がある項目であると考えられます。

また、「外国特許文献の調査」、「非特許文献等の調査」は、全体評価との相関は高くありませんが、評価の平均は、各項目の評価の中で相対的に低い項目です。

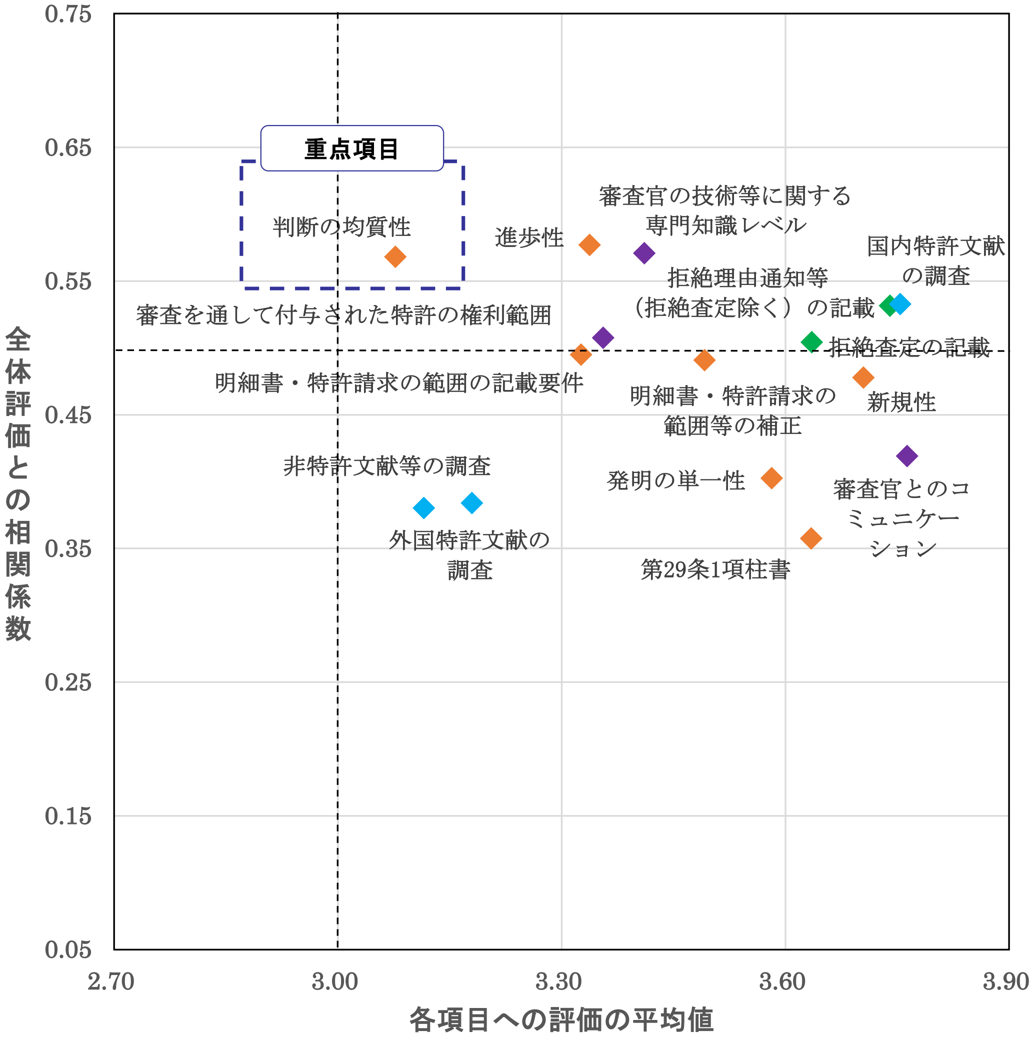

図 3：各評価項目の評価の平均値と、全体評価との相関係数（国内出願）[1]

[1]図中のマーカの色は、水色がサーチに関する項目、橙色が判断に関する項目、緑色が通知書等の記載に関する項目、紫色がその他の項目であることを示します。

（2）PCT：各評価項目の評価及び全体評価との相関

図 4[1]は、PCT 出願における国際調査等の質全般について（C 票）、個別項目の評価の平均と相関係数との関係を示したものです。「外国特許文献の調査」、「非特許文献等の調査」での評価の平均は、各項目の評価の平均において相対的に低い項目です。

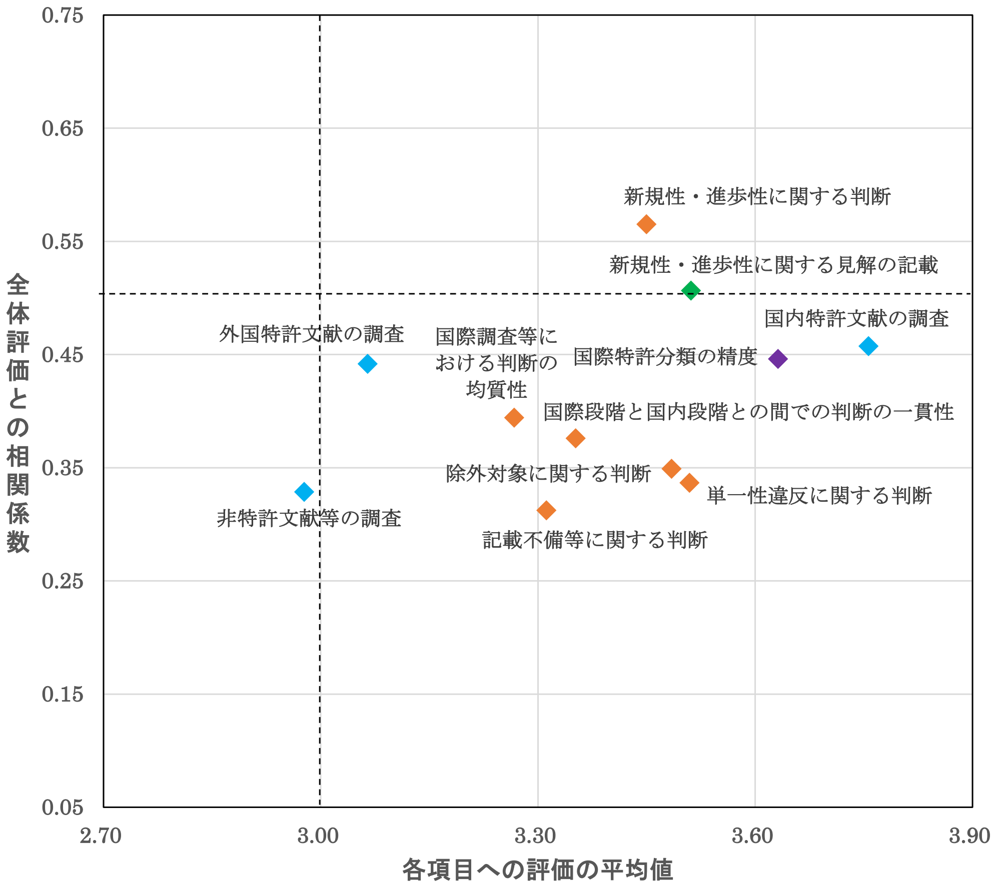

図 4：各評価項目の評価の平均値と、全体評価との相関係数（PCT 出願）

[1] 図中のマーカの色は、水色がサーチに関する項目、橙色が判断に関する項目、緑色が通知書等の記載に関する項目、紫色がその他の項目であることを示します。

2. 個別案件に関する評価及び分析
④ 特定の国内出願における特許審査の質について

調査対象となった特定の国内出願に関する特許審査の質について、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合は、平成 24 年度の調査開始時から 55%付近で推移しています。

「満足」又は「比較的満足」と回答された理由[1]として、「拒絶理由通知／拒絶査定の記載のわかりやすさ」、「新規性・進歩性に関する判断が適切である」との指摘が多くの割合を占めていました。

他方、「不満」、「比較的不満」と回答された理由として、「新規性、進歩性を欠いている理由についての判断」、「拒絶理由通知／拒絶査定の記載のわかりやすさ」、「記載要件（第 36 条第 4 項 1 号、第 36 条第 6 項）を満たしていないとする理由についての判断」の指摘が多くの割合を占めていました。

新規性、進歩性判断に対する不満の具体的な理由[2]は、「引用文献の認定」、「一致点・相違点についての判断」、「組合せ・動機づけについての判断」にありました。また、記載要件に対する不満の具体的な理由は、「サポート要件に関する判断」、「明確性要件に関する判断」にありました。

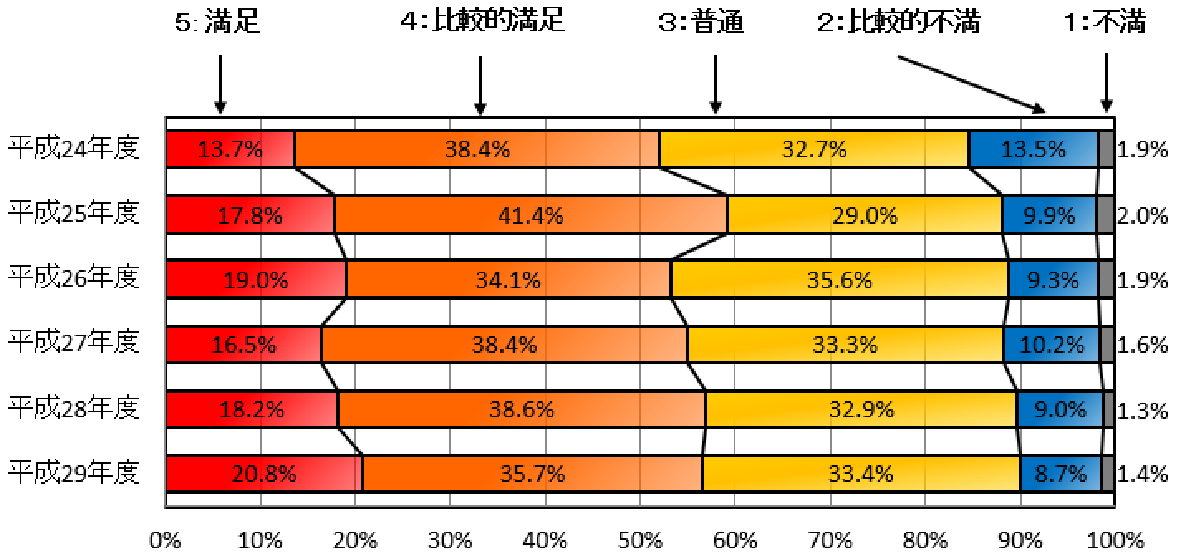

図 5：特定の国内出願における特許審査の質についての満足度

[1] 有効回答 998 件中、「拒絶理由通知／拒絶査定の記載内容が丁寧で分かりやすい」との指摘が 656 件、「新規性・進歩性に関する判断が適切である」との指摘が618件ありました。ここで、1つの回答に複数の理由が含まれる場合は意見ごとに集計しました。

[2] 新規性、進歩性を欠いている理由についての判断に対して不満と回答された 166 件において、「引用文献の認定」、「一致点・相違点についての判断」、「組合せ・動機づけについての判断」が具体的な不満理由であるとの指摘がそれぞれ、62 件、62 件、70 件ありました。また、記載要件を満たしていないとする理由について不満と回答された 36 件において、「サポート要件に関する判断」、「明確性要件に関する判断」が具体的な不満理由であるとの指摘がそれぞれ、14 件、11 件ありました。また、PBP クレームに関する指摘が 7 件ありました。なお、これらの進歩性、記載要件に係る指摘について、複数の指摘があった場合には、それぞれについてカウントしました。

⑤ 特定の PCT 出願における国際調査等の質について

調査対象となった特定の PCT 出願における国際調査等の質について、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合は、平成 24 年度の調査開始時から 55%付近で推移しています。

「満足」又は「比較的満足」と回答された理由[1]として、「国際調査報告・見解書等の記載のわかりやすさ」、「新規性・進歩性に関する判断が適切である」との指摘が多くの割合を占めていました。

他方、「不満」、「比較的不満」と回答された理由として、「新規性・進歩性を欠いている理由についての判断」の指摘が多くの割合を占めていました。

新規性・進歩性を欠いている理由についての判断に不満がある具体的な理由[2]としては、「組合せ・動機づけについての判断」、「一致点、相違点についての判断」、「引用文献の認定」がその理由として挙げられていました。

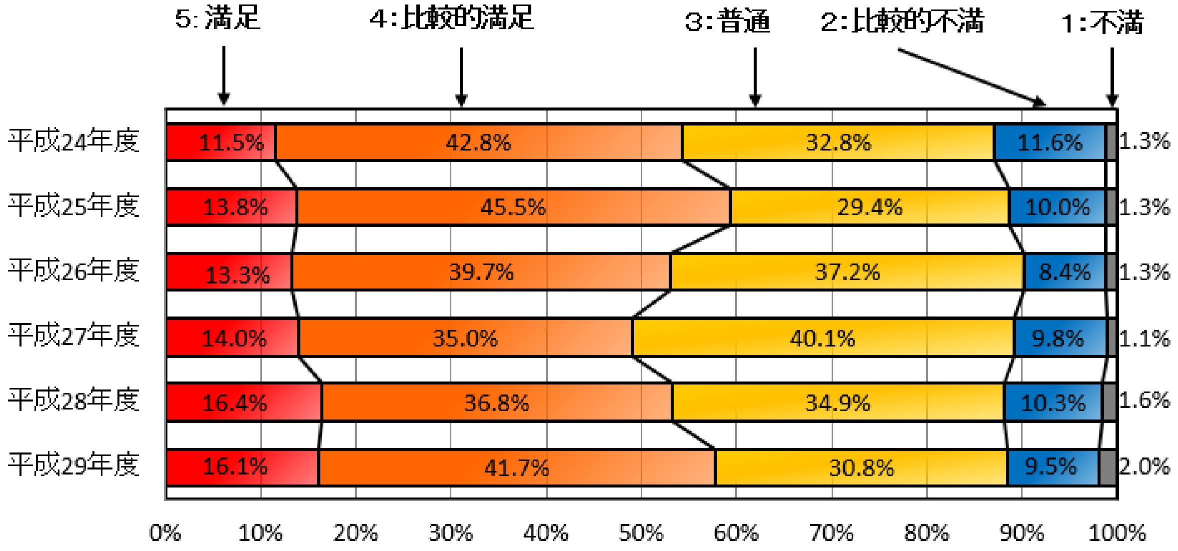

図 6：特定の PCT 出願における国際調査等の質についての満足度

---

[1] 有効回答 384 件中、「国際調査報告・見解書等の記載のわかりやすさ」の指摘が 252 件、「新規性・進歩性に関する判断が適切である」との指摘が 254 件ありました。なお、1つの回答に複数の理由が含まれる場合は意見ごとに集計しました。

[2] 新規性、進歩性を欠いている理由についての判断に対して不満と回答された 66 件において、「引用文献の認定」、「一致点、相違点についての判断」、「組合せ・動機づけについての判断」が具体的な不満内容であるとの指摘が 28 件、32 件、34 件ありました。

⑥ 不満内容の分析

特定の国内出願における特許審査の質や、特定の PCT 出願における国際調査等の質について、調査の対象となった特定案件に対する不満の内容と、自由記入欄に回答があった個別案件に対する不満の内容の分析を行いました。

下記図 7 は、調査の対象となった特定案件全件及び自由記載の回答により特許審査の手続や質に問題があったと思われる案件全件に対する、新規性・進歩性、記載要件、均質性、サーチに対して不満とされた案件の割合を示したものです。特に新規性・進歩性に関する不満が多いことが分かりました。

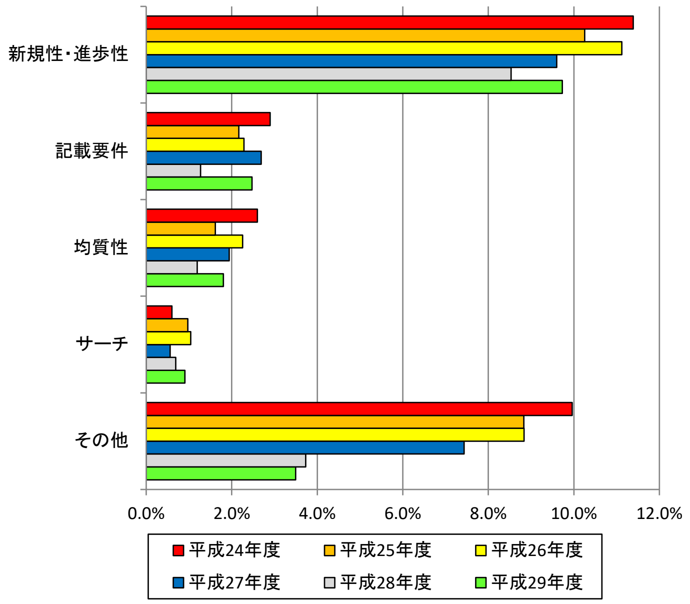

図 7：質に関して不満とされた率の経年変化とその内容の内訳

Ⅲ. 分析結果のポイントについて

国内の特許審査における質全般（調査票Ａ票）について、「満足」又は「比較的満足」の肯定的な回答の割合は調査開始より年々増加し、平成 29 年度は、58. 3%でした。
国内の特許出願の質に関する個別の項目（「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」等）に対する評価では、各項目への評価は概ね向上しておりました。特に、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が 60%以上を占める、高評価の項目は、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」（67. 3%）、「国内特許文献の調査」（65. 7%）、「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション」（62. 1%）でした。この中でも特に、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」の項目では、「満足」又は「比較的満足」の割合が、平成 24 年の調査開始時から、30%以上向上していました。また、「判断の均質性について」の項目では、依然として「比較的不満」又は「不満」と回答した割合が 20%以上を占めていたものの、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合は、着実な改善傾向が見受けられました（第ⅱ頁参照）。

PCT 出願における国際調査等の質全般（調査票Ｃ票）においても、「満足」又は「比較的満足」の肯定的な回答の割合が調査開始より年々向上し、本年度は初めて半数を超え、54. 2%にまで向上していました。
PCT 出願の質に関する個別の項目（「国際特許分類の精度」等）に対する評価では、各項目への評価は概ね向上しておりました。特に、「国内特許文献の調査」（65. 5%）、「国際特許分類の精度」（53. 3%）、「新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさ」（51. 2%）の 3 項目は、「満足」～「不満」のうち、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が 50%以上を占めていました。また、「外国特許文献の調査」の項目については、否定的な回答の割合には昨年度からの変化が見受けられなかったものの、肯定的な回答の割合が 15. 9%から 26. 1%にまで向上していました（第ⅲ頁参照）。
これらのことから、特許庁でこれまで取り組んできた、審査の質向上のための取組が、着実にユーザーの評価に結びついていると考えられます。

一方で、調査票Ｂ票・Ｄ票において、調査の対象となった特定案件や、自由記載の回答により、特許審査の手続や質に問題があったと思われる案件に対する不満の内容について、分析を行ったところ、特に新規性・進歩性に関する不満が多いことがわかりました（第ⅷ頁）。また、同一技術分野内・異なる技術分野間での判断の相違は、本年度、不満があるとされた率が比較的高く、増加傾向にありました。このことから、調査票Ａ票の国内の特許出願の質に関する個別の項目の評価において、比較的評価が低かった判断の均質性について、個別案件においても不満とされた率が増加していることがわかりました。
今後は、これまでの審査の質向上のための取組を着実に実施しつつ、今回のユーザー評価調査における、全体評価に対する個別項目の評価の影響に係る分析結果や（第ⅳ～ⅴ頁を参照）、特許庁で実施している他の分析結果を踏まえて、総合的な視点から課題・改善点の抽出を行い、今回抽出された判断の均質性等の課題の改善に取り組んで行く必要があります。

謝辞
　本調査の実施にあたりましては、多くのユーザーの皆様にご協力をいただきました。ここに、心より感謝の意を表します。
　審査の質の維持・向上のためには、ユーザーの皆様による審査の品質評価を継続し、その結果に基づいて、特許審査及びその関連業務の継続的な改善を推進して行くことが必要です。引き続きご協力をお願い致します。

目次

要約 I

1. 調査の概要 1

（1）背景 1
（2）本調査の目的 1
（3）ユーザー評価の収集方法 1
（4）調査票について 2
（5）調査対象者 2
（6）回答率について 3
（7）本報告書における「満足」及び「不満」の用語について 4
（8）昨年度からの変更点 4

2. 集計結果 6

（1）国内出願における特許審査の質について 6
①国内出願における特許審査の質全般について 6
②国内出願における特許審査の質に関する項目別の評価について 6
③他国庁との比較について 13
④自由記入欄への回答 15

（2）PCT 出願における国際調査等の質について 16
①PCT 出願における国際調査等の質全般について 16
②国際調査等の項目別の質の評価について 17
③他国庁との比較について 22
④自由記入欄への回答 22

（3）特定の国内出願における特許審査の質について 23
①調査対象案件における特許審査の質について（全般） 23
②調査対象案件における特許審査の質に肯定的な回答をした理由について 24
③調査対象案件における特許審査の質に否定的な回答をした理由について 25

（4）特定の PCT 出願における国際調査等の質について 26
①調査対象案件における国際調査等の質 26
②調査対象案件における国際調査等の質に肯定的な回答をした理由について 26
③調査対象案件における国際調査等の質に否定的な回答をした理由について 27

3. 回答内容の詳細分析 28

（1）各評価項目と全体評価との相関分析 28
① 分析の内容 28
② 個別の項目への評価の全体評価への影響（国内出願） 28

（2）個別案件の具体的に不満があるとされた事項の分析について 33
① 分析の内容 33
② 不満内容全体としての傾向 35
③ 新規性・進歩性に関する不満について 36
④ 記載要件に関する不満について 36
⑤ 判断の均質性に関する不満について 37
⑥ サーチに関する不満について 37

4. 分析結果のポイント 38

5. 今後のユーザー評価調査に向けて 39

謝辞 39

（付録）調査票（A－D 票） 40

図 1：国内出願における特許審査の質全般の満足度 6
図 2：拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさの満足度 8
図 3：拒絶査定の記載のわかりやすさの満足度 8
図 4：面接、電話等における審査官とのコミュニケーションの満足度 9
図 5：判断の均質性についての満足度 9
図 6：第 29 条第 1 項各号（新規性）の満足度 10
図 7：第 29 条第 2 項（進歩性）の満足度 10
図 8：記載要件の判断についての満足度 10
図 9：国内特許文献の調査の満足度 11
図 10：外国特許文献の調査の満足度 11
図 11：非特許文献等の調査の満足度 12
図 12：他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が提示される頻度（国内） 15
図 13：国際調査等の質全般の満足度 16
図 14：国際特許分類の精度の満足度 18
図 15：新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさの満足度 18
図 16：国際調査等での国内特許文献の調査の満足度 19
図 17：国際調査等での外国特許文献の調査の満足度 19
図 18：国際調査等での非特許文献等の調査の満足度 20
図 19：国際調査等における判断の均質性についての満足度 21
図 20：国際段階と国内段階との間での判断の一貫性の満足度 21
図 21：他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が提示される頻度（PCT） 22
図 22：特定の国内出願における特許審査の質の満足度 23
図 23：特定の PCT 出願における国際調査等の質の満足度 26
図 24：個別の評価項目の評価と全体評価の関係 28
図 25：各評価項目の評価の平均値と、全体評価との相関係数（国内出願） 29
図 26：全体評価に対する相関・評価の平均の変化（国内出願） 30
図 27：各評価項目の評価の平均値と、全体評価との相関係数（PCT 出願） 31
図 28：全体評価に対する相関・評価の平均の変化（PCT 出願） 32
図 29：不満とされた事項の分類項目一覧 34
図 30：質に関して不満とされた率の経年変化とその内容の内訳 35
図 31：新規性・進歩性に関して不満とされた理由の内訳 36
図 32：記載要件に関して不満とされた理由の内訳 36
図 33：審査の判断の均質性に関して不満とされた理由の内訳 37
図 34：サーチに関して不満とされた理由の内訳 37

表 1：A・B 票（国内出願）の対象者・対象案件の選定方法等 2
表 2：C・D 票（PCT 出願）の対象者・対象案件の選定方法等 3
表 3：調査票の回答率 3
表 4：A・C 票回答者の業種内訳 4
表 5：特許審査の項目別の評価 7
表 6：日本国特許庁が他国の特許庁よりも優れていると感じる点 13
表 7：日本国特許庁よりも優れていると感じる点がある他国の特許庁についての回答数 13
表 8：日本国特許庁よりも他国の特許庁の方が優れていると感じる点 14
表 9：国内：他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が提示される頻度 15
表 10：PCT 出願の項目別回答数 17
表 11：PCT：他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が提示される頻度 22
表 12：最終処分別での特定の国内出願における 5 段階評価 24
表 13：国内の特定案件の質について、満足と回答した理由の集計結果 24
表 14：最終処分別での満足と回答した理由の集計結果 24
表 15：特定案件の特許審査の質に不満がある理由 25
表 16：PCT 特定案件の質（満足と回答した理由の集計結果） 26
表 17：特定案件の国際調査等の質に不満がある理由 27

1.　調査の概要

（1） 背景

国際的に信頼される質の高い審査及び適切な権利設定が、企業の円滑かつグローバルな事業展開を支援し、イノベーションの促進や健全な取引維持を図る上で重要です。このような認識のもと、特許庁は、世界最高品質の特許審査の実現に取り組むための品質管理の基本原則を示した「特許審査に関する品質ポリシー」（以下、「品質ポリシー」といいます。）を 2014 年 4 月に公表しました。品質ポリシーでは、6 つの基本原則の 1 つとして「幅広いニーズや期待に応えます」という原則を掲げ、これを受けて「我が国社会の利益及び特許制度に関わる方々の満足に資するよう、特許審査に対する幅広いニーズや期待を把握し尊重していきます。」と謳っています。

また、品質検証のための取組を充実させるためには、ユーザーの声を真摯に受け止めることが重要です。そこで、ユーザーの声を品質管理施策に反映させるため、平成 24 年度よりユーザー評価調査を実施しています。

本報告書では、調査結果の概要とともに、回答内容を詳細に分析した結果及びこれらを総合して得られた知見について報告をします。

（2） 本調査の目的

上記の背景を踏まえ、本調査は、特許審査・国際調査等の質について、ユーザーの皆様からの評価、意見等を収集し、特許審査の質の現状を把握するためのデータとして活用すると共に、今後の特許審査・国際調査等の質の改善に役立たせることを目的としています。

すなわち、本調査は、品質マニュアルにおいて説明されるところの「特許審査の質の維持・向上のためのサイクル（PDCA サイクル）」において、特許審査業務の評価（CHECK）として位置づけられます。そして、品質ポリシーに掲げられた「継続的に業務を改善します」という原則も実践すべく、特許審査及びその関連業務の継続的な改善のために活用していきます。

（3） ユーザー評価の収集方法

下記（5）のように抽出した調査対象者に対し、電話連絡又は電子メールにより、調査への協力を依頼するとともに、電子メールにより下記（4）の調査票を送付しました。

回答期間は約 1 か月とし、この期間内での回答の記入及び電子メール又は郵送により返送を依頼しました。本調査は平成 29 年 6 月－8 月に調査票の配付及び回収を順次実施しました。

また、下記（4）の A 票及び C 票の回答に際して、ユーザーが記名での回答と無記名での回答を任意に選択できる形式（任意記名式）で調査を行っています。

（4）調査票について

以下 4 種類の調査票（付録参照）を用いてユーザー評価の収集を行いました。

A 票 ： 国内出願における特許審査の質全般について

B 票 ： 特定の国内出願における特許審査の質について

C 票 ： PCT 出願における国際調査等の質全般について

D 票 ： 特定の PCT 出願における国際調査等の質について

なお、在外出願人の調査にあたっては、必要に応じて A 票及び B 票を英訳した調査票（付録参照）を用いています。

（5）調査対象者

表 1 は、A・B 票（国内出願）に関する対象者・対象案件の選定方法と、その者数・案件数を示したものであり、表 2 は、C・D 票（PCT 出願）に関する対象者・対象案件の選定方法と、その者数・案件数を示したものです。なお、A 票及び C 票の対象者には重複があり、この重複を除くと対象者は合わせて 725 者でした。在外出願人については、A 票・B 票の対象者数を昨年度と同じく 59 者としました。代理人については、代理した出願数の多い代理人に対して、代理人の視点からの回答を要請しました。

表 1：A・B 票（国内出願）の対象者・対象案件の選定方法等

<table>
<tr><th></th><th>対象者／対象案件の選定方法</th><th colspan="2">者数／案件数</th></tr>
<tr><td rowspan="4">A 票</td><td>2015 年度に筆頭出願人として 50 件以上の国内出願を行った内国出願人（個人を除く。）のうち、2016 年度に査定謄本の送達があった者</td><td>551 者</td><td rowspan="4">681 者</td></tr>
<tr><td>2015 年度に筆頭出願人として 120 件以上の国内出願を行った在外出願人（個人を除く。）のうち、2016 年度に査定謄本の送達があった者</td><td>59 者</td></tr>
<tr><td>小規模出願人[*1]</td><td>19 者</td></tr>
<tr><td>代理人[*2]</td><td>52 者</td></tr>
<tr><td>B 票</td><td>A 票の対象者が筆頭出願人となっている国内出願のうち、2016 年度に特許査定又は拒絶査定がなされた案件の中からランダム抽出[*3]</td><td colspan="2">1970 件</td></tr>
</table>

*1 2015 年度に筆頭出願人として 50 件未満の国内出願を行った内国出願人である企業（製造業に限る。）から、過去の特許庁との面談や意見交換の実績等を踏まえて任意に抽出した。

*2 2016 年度における出願代理件数で上位者を抽出した。

*3 回答負担を考慮して 1 者あたりの対象案件数の下限を 2 件、上限を 5 件とし、対象者の 2015 年度の筆頭国内出願件数に応じて 2～5 件を割り当てるように調整した。

表 2：C・D 票（PCT 出願）の対象者・対象案件の選定方法等

	対象者／対象案件	者数／案件数	
C 票	2016 年度に筆頭出願人として 18 件以上の PCT 出願を行った内国出願人（個人を除く）のうち、2016 年度に国際調査報告又は国際予備審査報告の発送があった者	290 者	336 者
	小規模出願人[*1]	19 者	
	代理人[*2]	27 者	
D 票	C 票の対象者が筆頭出願人となっている PCT 出願のうち、2016 年度に国際調査報告又は国際予備審査報告が発送された PCT 出願の中からランダム抽出[*3]	731 件	

*1　2016 年度に筆頭出願人として 18 件未満の PCT 出願を行った内国出願人である企業（製造業に限る。）から、過去の特許庁との面談や意見交換の実績等を踏まえて任意に抽出した。

*2　2016 年度における出願代理件数で上位者を抽出した。

*3　回答負担を考慮して 1 者あたりの対象案件数の下限を 2 件、上限を 5 件とし、対象者の 2016 年度の筆頭 PCT 出願件数に応じて 2～5 件を割り当てるように調整した。

(6)　回答率について

調査票の A 票～D 票の回収率は、昨年度から若干増加し、約 89%～約 92%でした（表 3 参照）。約 90%の回答率で回答が得られており、ユーザーからご理解をいただくと共に、積極的にご協力いただいています。

また、表 4 は、A 票と C 票それぞれの回答者の業種内訳[1]を示したものです。

全体の回答に占める無記名での回答の割合は A 票で約 55.6%（昨年度は約 48.4%）、C 票で約 60.6%（昨年度は約 53.3%）でした（表 4 参照）。

表 3：調査票の回答率

	配付済	回答済み	回答率	（参考）2016 年度回答率	（参考）2015 年度回答率	（参考）2014 年度回答率	（参考）2013 年度回答率	（参考）2012 年度回答率
A 票	681 者	617 者	90.6%	89.3%	85.5%	86.8%	91.8%	91.4%
B 票	1970 件	1765 件	89.6%	88.9%	85.1%	87.5%	90.6%	91.7%
C 票	336 者	310 者	92.3%	91.2%	87.4%	88.7%	90.6%	91.8%
D 票	731 件	665 件	91.0%	93.4%	89.1%	90.4%	90.1%	93.0%

[1] 回答者の業種を、東証 33 業種、帝国データバンク産業分類表、日本標準産業分類、ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関する調査研究報告書(平成 23 年 2 月)、特許審査の出願人等による評価を踏まえた品質監理手法に関する調査研究報告書(平成 20 年 3 月)等を参考にして 9 業種(回答者が代理人の場合も含めると10業種)に分類しています。なお、「その他工業」は製造業のうち、金属、建設、機械、化学、食品・医薬、電気に分類されないもの(文具、玩具、スポーツ用品など)を意味し、「その他」は、製造業以外のもの(サービス業、運輸業、金融業など)を意味します。

表 4：A・C 票回答者の業種内訳

属性		A 票		C 票	
	業種[*1]	回答者数	割合	回答者数	割合
内国出願人	金属	20	3.2%	10	3.2%
	建設	6	1.0%	0	0.0%
	機械	63	10.2%	28	9.0%
	化学	40	6.5%	24	7.7%
	食品・医薬	7	1.1%	3	1.0%
	電気	.76	12.3%	33	10.6%
	その他工業	12	1.9%	4	1.3%
	その他	9	1.5%	6	1.9%
	学校・公的研究機関等	7	1.1%	1	0.3%
代理人		26	4.2%	13	4.2%
在外出願人		8	1.3%	0	0.0%
無記名		343	55.6%	187	60.6%
合計		617	100.0%	310	100.0%

*1　回答者の業種を、東証 33 業種、帝国データバンク産業分類表、日本標準産業分類、ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関する調査研究報告書(平成 23 年 2 月)、特許審査の出願人等による評価を踏まえた品質監理手法に関する調査研究報告書(平成 20 年 3 月) 等を参考にして 9 業種（回答者が代理人の場合も含めると 10 業種）に分類しています。なお、「その他工業」は製造業のうち、金属、建設、機械、化学、食品・医薬、電気に分類されないもの（文具、玩具、スポーツ用品など）を意味し、「その他」は、製造業以外のもの（サービス業、運輸業、金融業など）を意味します。

(7) 本報告書における「満足」及び「不満」の用語について

調査票（付録参照）では、各項目に関する評価を 5（満足)、4（比較的満足)、3（普通)、2（比較的不満)、1（不満）の 5 段階で行いました。

本報告書では、特に断りがない限り、ユーザーが 5（満足）及び 4（比較的満足）と回答した場合を合わせて「肯定的な回答」、1（不満）及び 2（比較的不満）と回答した場合を合わせて「否定的な回答」とします。

(8) 昨年度からの変更点

今年度の調査では、主に以下の点で調査票を変更しました。

- ✓ 国内出願における特許審査の質全般を問う調査票（A 票）において、「審査官とのコミュニケーション（面接、電話による連絡等)」を「面接、電話等による審査官とのコミュニケーション」に変更しました。
- ✓ 国内出願における特許審査の質全般を問う調査票（A 票）の「拒絶理由通知等の記載」、「拒絶査定の記載」の設問と、PCT 出願における国際調査等の質全般を問う調査票（C 票）の「新規性・進歩性に関する見解の記載」の設問に、「わかりやすさ」の文言を追記して、「拒絶理由通知等の記載のわかりやすさ」、「拒絶査定の記載のわかりやすさ」、「新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさ」に変更しました。

- ✓ 国内出願における特許審査の質全般を問う調査票（A 票）及び PCT 出願における国際調査等の質全般を問う調査票（C 票）で、他国の特許庁と日本国特許庁の何れが優れているかを問うていた設問を、国内出願における特許審査の質全般の調査票（A 票）のみの設問とします。また、優れていると感じる点や優れていると感じる点がある特許庁の他に、他国の特許庁で審査を受けた経験がない、わからない場合と、特に優れていると感じる点はない場合の選択肢を設けました。
- ✓ 国内出願における特許審査の質全般を問う調査票（A 票）および PCT 出願における国際調査等の質全般を問う調査票（C 票）に、米欧中韓の特許庁及びその他の国／地域の特許庁において、最近 1 年間でより適切な引用文献が提示される頻度を問う設問を追加しました。
- ✓ 国内出願における特許審査の質全般を問う調査票（A 票）および PCT 出願における国際調査等の質全般を問う調査票（C 票）の個別項目における選択肢について、「わからない」を「わからない／経験がない」に変更しました。
- ✓ 特定の国内出願における特許審査の質を問う調査票（B 票）および特定の PCT 出願における国際調査等の質を問う調査票（D 票）への回答内容について、昨年度までは担当審査官へのフィードバック可の場合にチェックを付ける回答欄にしていたところを、担当審査官へのフィードバック不可の場合にチェックを付ける回答欄に変更しました。

2. 集計結果

（1）国内出願における特許審査の質について

① 国内出願における特許審査の質全般について

肯定的な回答の割合[1]は、58. 3%でした。平成 24 年度の調査開始時より、肯定的な回答の割合は、年々向上しています。

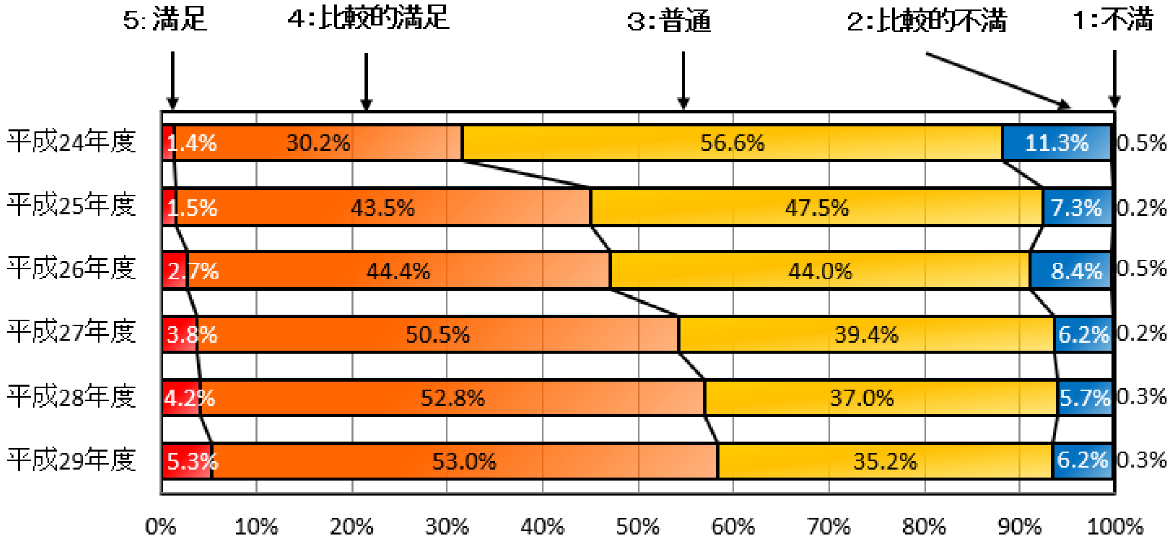

図 1：国内出願における特許審査の質全般の満足度

② 国内出願における特許審査の質に関する項目別の評価について

表 5 は、項目別の評価件数を示したものです。また、図 2～図 11 は、「5：満足」～「1：不満」の解答割合を項目別に示したものです。

「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が 60%以上を占める、高評価の項目は、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」（67. 2%）、「国内特許文献の調査」（65. 7%）、「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション」（62. 1%）でした。この中でも特に、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」の項目では、「満足」又は「比較的満足」の割合が、平成 24 年の調査開始時から、30%以上向上していました。

また、「第 29 条 2 項（進歩性）」と、「第 36 条 4 項 1 号、第 36 条 6 項（明細書・特許請求の範囲の記載要件）」の設問において、平成 29 年度は、「比較的不満」又は「不満」の否定的な回答の割合がそれぞれ、14. 8%、13. 8%となり、昨年度に引き続き 20%以下となるとともに、平成 24 年度の調査開始以来、初めて、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が 40%を超えました。

[1] 「5：満足」～「1：不満」の解答割合の経年変化を示すグラフでは、「わからない」、「無回答」の割合を除いています。

一方、「判断の均質性について[1]」の項目では、着実な改善傾向が見受けられたものの、「比較的不満」又は「不満」と回答した割合が 20%以上を占めていました。「外国特許文献の調査」、「非特許文献等の調査」については、昨年度と比べると、「満足」又は「比較的満足」の割合が、それぞれ約 7%、約 6%向上していました。

表 5：特許審査の項目別の評価

質問項目		満足	比較的満足	普通	比較的不満	不満	分からない
拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ		70	344	177	22	3	1
拒絶査定の記載のわかりやすさ		64	289	228	26	2	8
条文の運用に関して	第 29 条 1 項柱書（産業上の利用可能性、「発明」に該当するか否かの判断）	77	155	225	10	1	149
	第 29 条 1 項各号（新規性）	95	270	222	24	2	4
	第 29 条 2 項（進歩性）	34	236	255	86	5	1
	第 36 条第 4 項第 1 号、第 36 条第 6 項（明細書・特許請求の範囲の記載要件）	40	218	270	72	13	4
	第 37 条（発明の単一性）	76	174	267	11	3	86
	第 17 条の 2 第 3 項～6 項（明細書、特許請求の範囲等の補正）	47	201	288	16	3	62
判断の均質性について		19	166	286	119	19	7
サーチ	国内特許文献の調査	87	316	189	17	5	3
	外国特許文献の調査	25	141	321	71	9	50
	非特許文献等の調査	26	115	307	73	16	80
審査官の技術等に関する専門知識レベル		36	247	267	59	4	4
面接、電話等における審査官とのコミュニケーション		91	213	168	15	3	127
審査を通して付与された特許の範囲の権利範囲について		19	233	307	41	7	10

[1] 平成 27 年度までは、設問を「ばらつきのない判断」として調査していた。

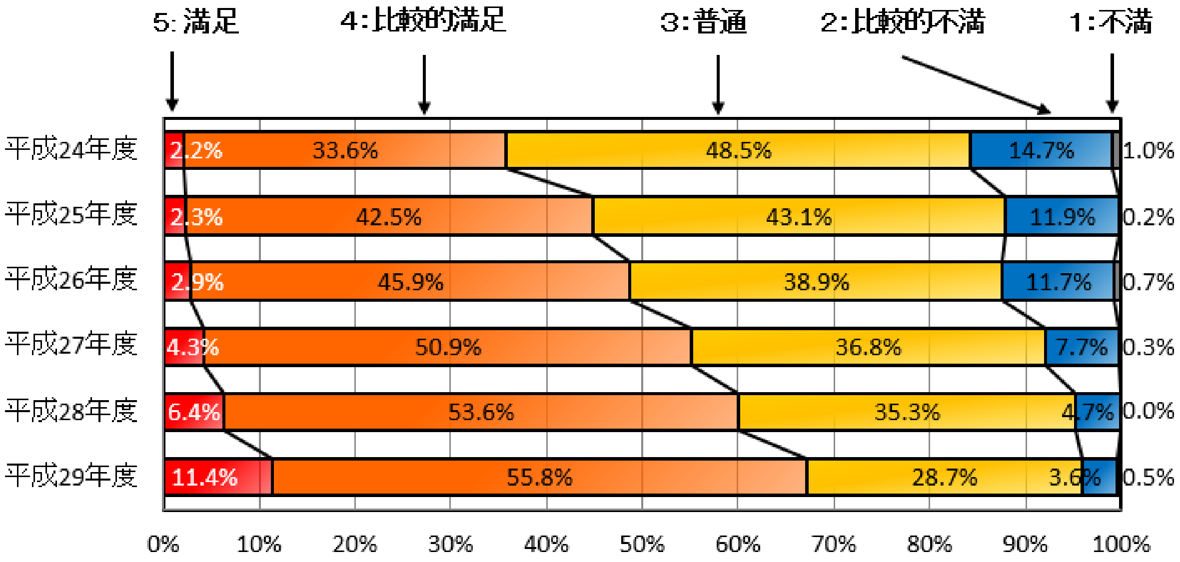

図 2：拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさの満足度

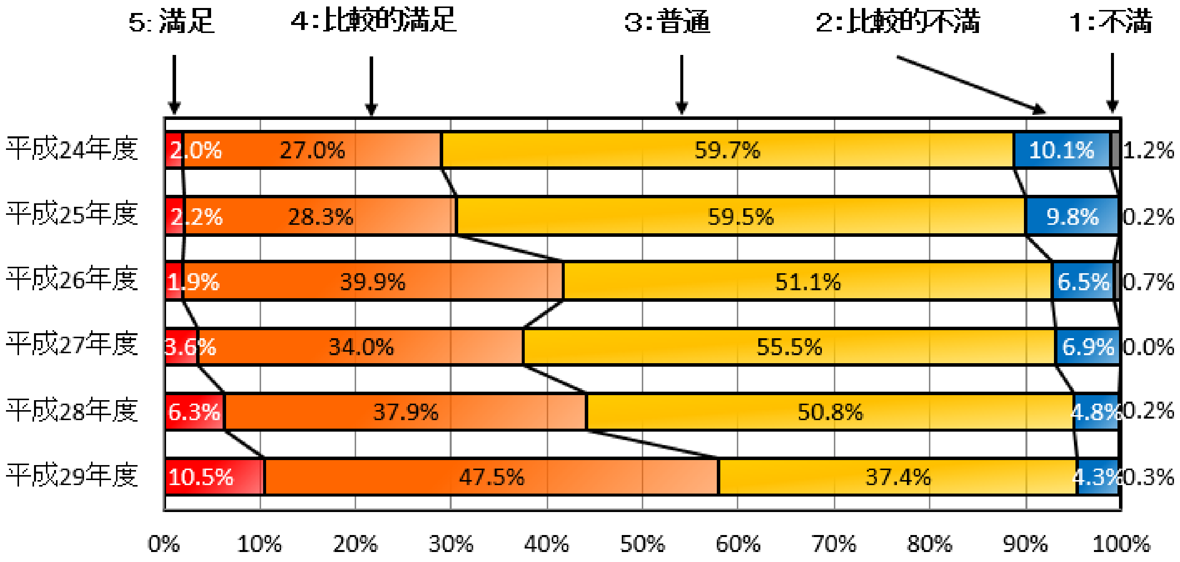

図 3：拒絶査定の記載のわかりやすさの満足度

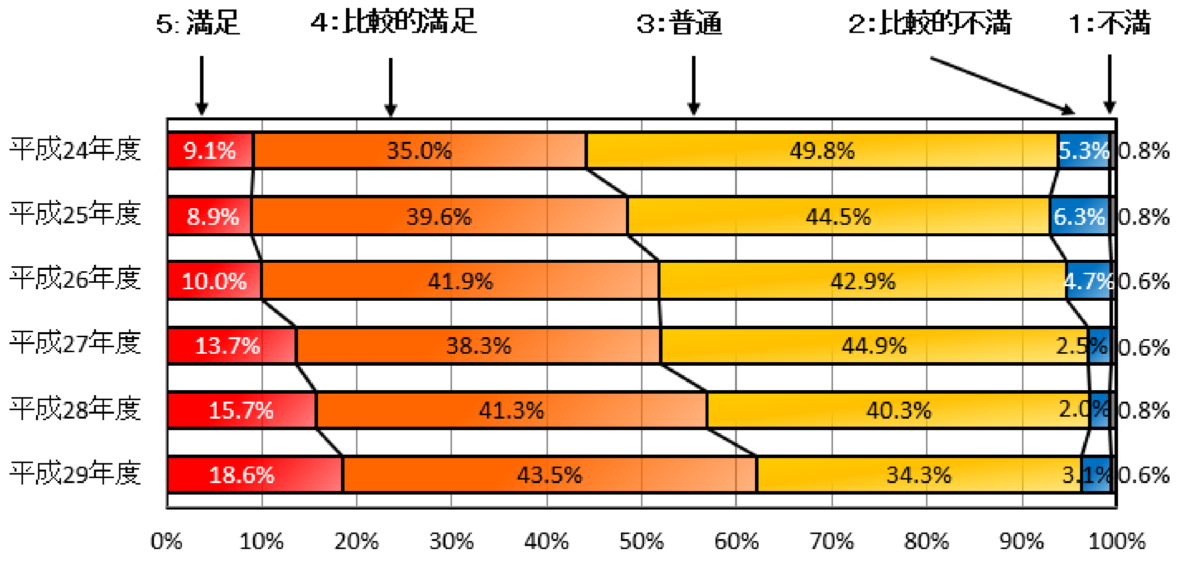

図 4：面接、電話等における審査官とのコミュニケーションの満足度

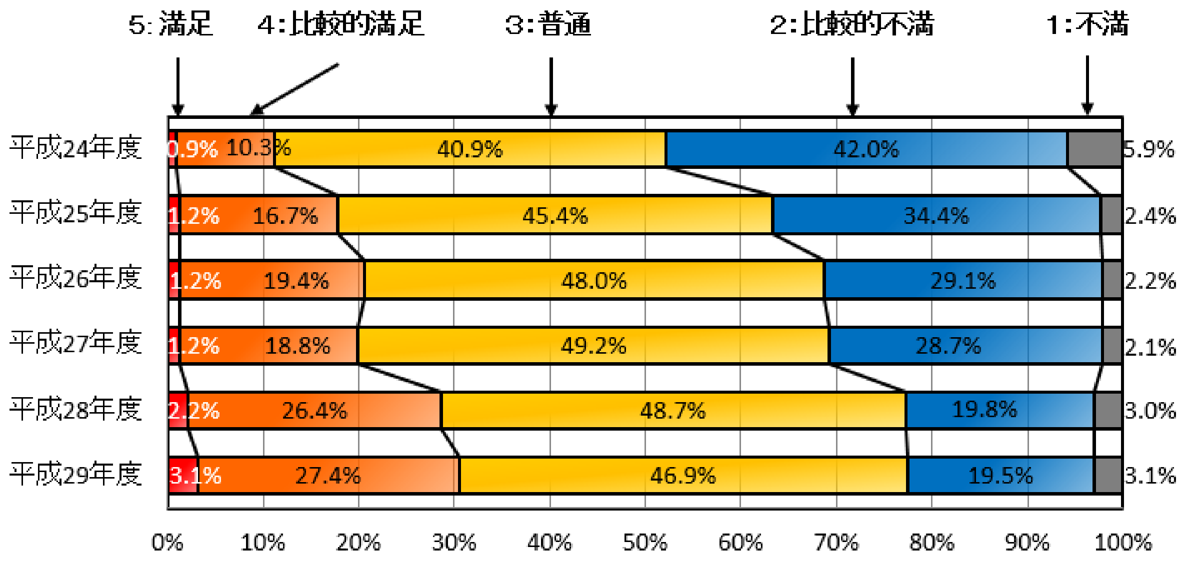

図 5：判断の均質性についての満足度

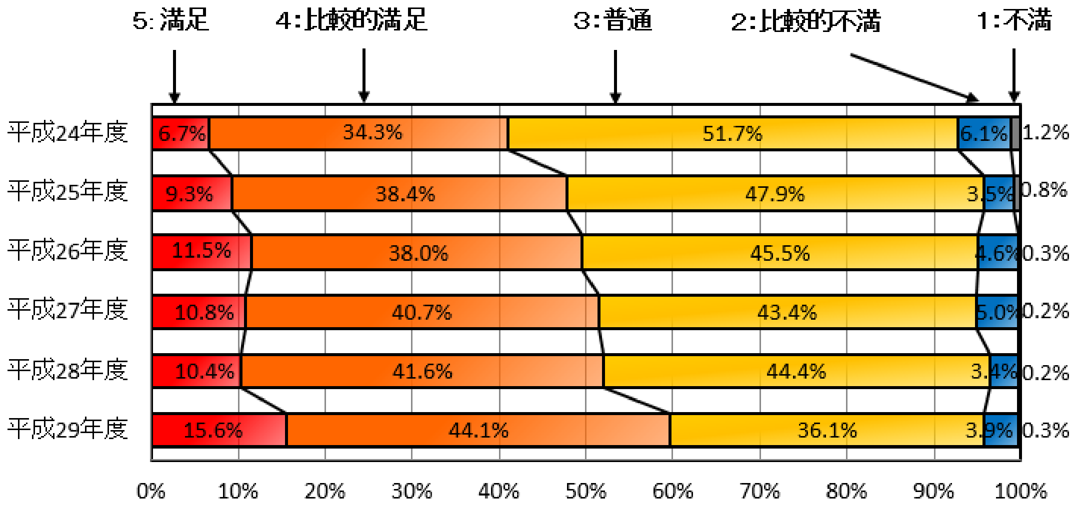

図 6：第 29 条第 1 項各号（新規性）の満足度

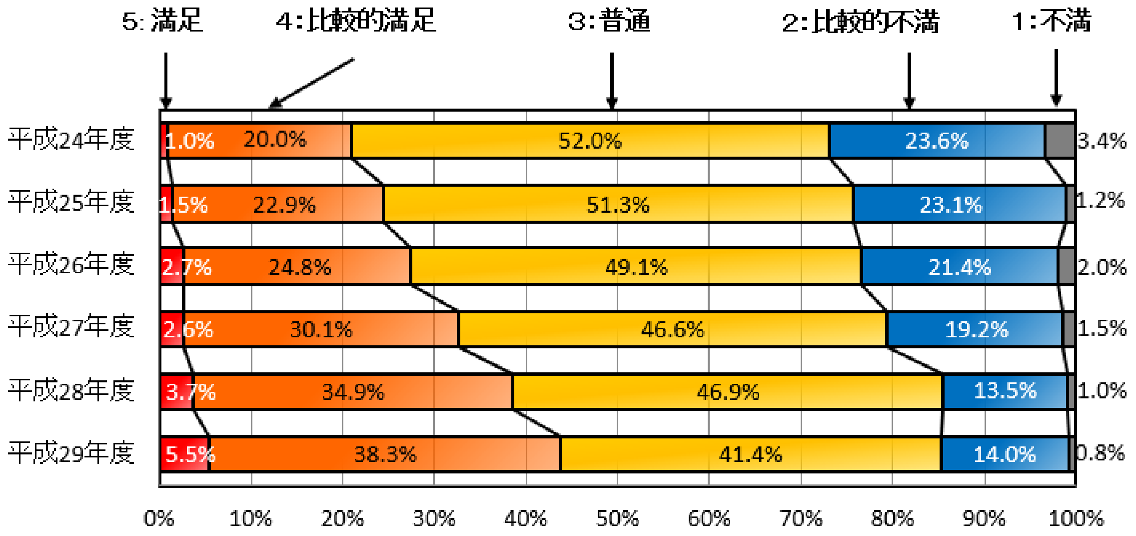

図 7：第 29 条第 2 項（進歩性）の満足度

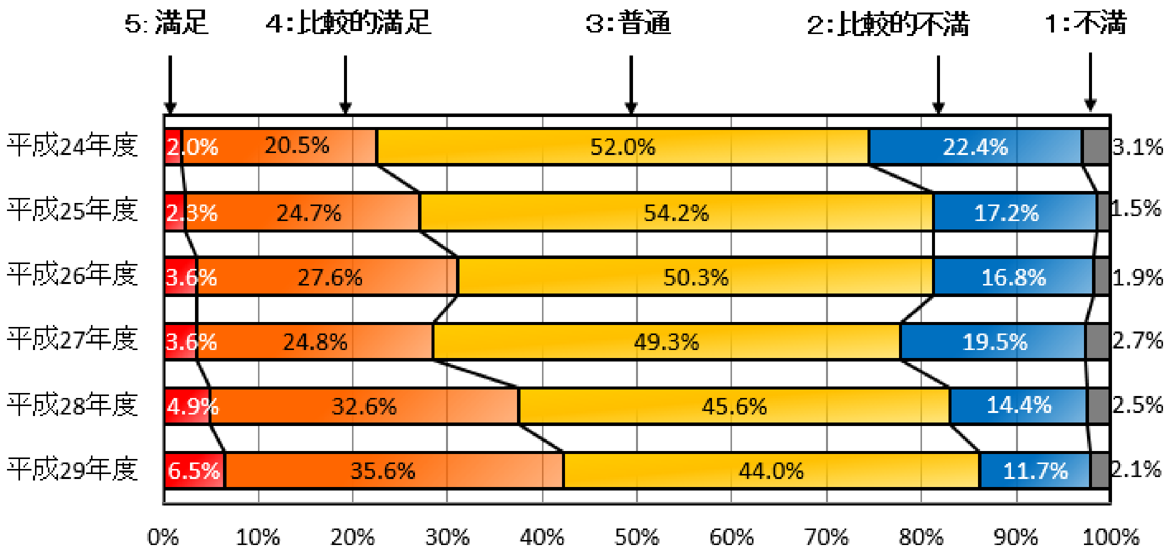

図 8：記載要件の判断についての満足度

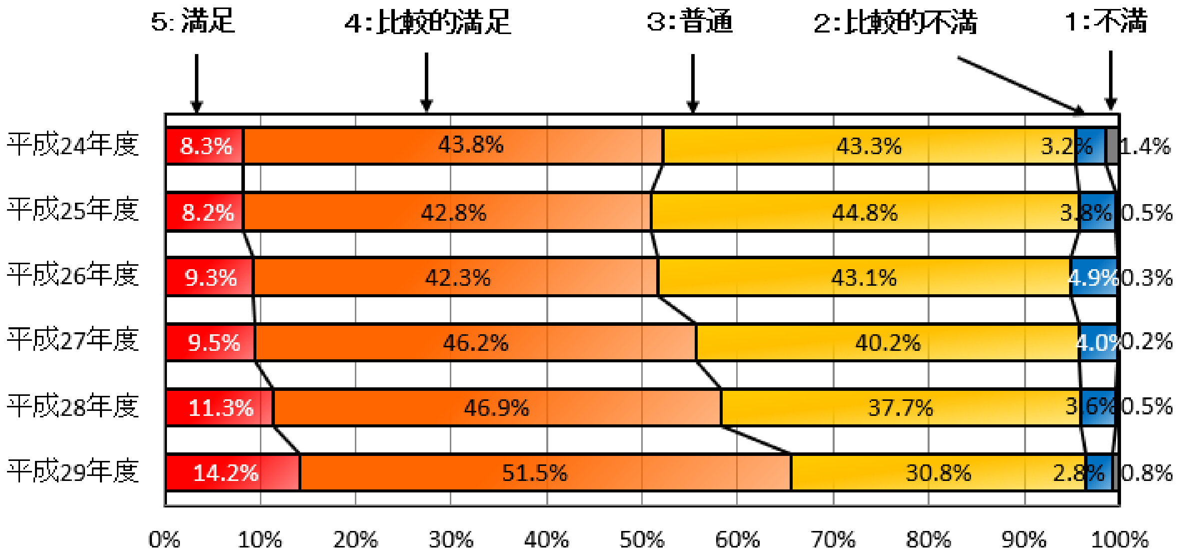

図 9：国内特許文献の調査の満足度

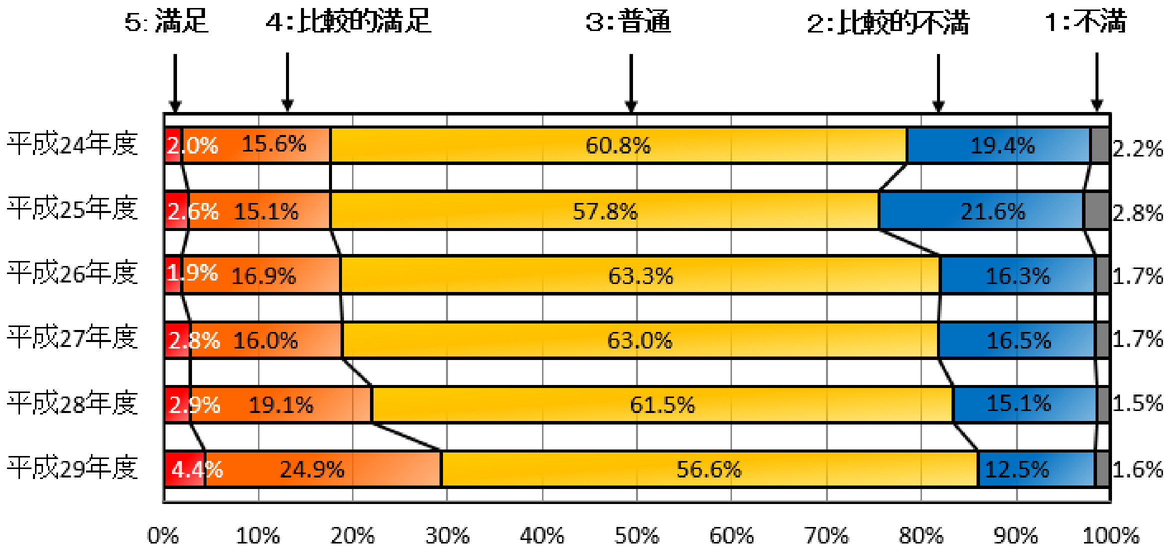

図 10：外国特許文献の調査の満足度

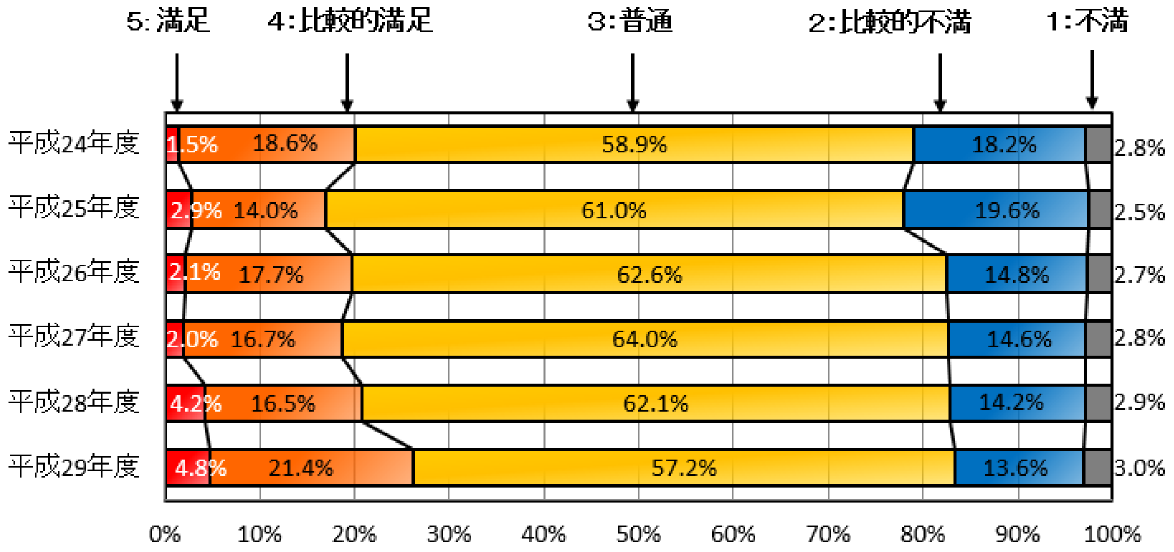

図 11：非特許文献等の調査の満足度

③ 他国庁との比較について

表 6は、特許審査の質に関し、日本国特許庁の方が他国の特許庁よりも優れていると感じる点を集計したものです[1]。

表 6から、日本国特許庁が他国の特許庁と比べ、最も高く評価されている項目は、審査官の技術理解力でした。

表 6：日本国特許庁が他国の特許庁よりも優れていると感じる点

有効回答	回答数[2]	（参考）[3] 昨年度回答数
審査官の技術理解力	309	300
先行技術文献調査	242	240
新規性・進歩性等の判断	224	252
拒絶理由通知書等の記載のわかりやすさ	259	206
電話、面接等における審査官とのコミュニケーション	159	－

表 7は、国内出願における特許審査の質に関し、日本国特許庁よりも優れていると感じる点がある他国の特許庁の回答数を集計したものです。

表 7：日本国特許庁よりも優れていると感じる点がある他国の特許庁についての回答数

	特に感じる点はない	欧州特許庁	米国特許商標庁	中国国家知識財産権局	韓国特許庁	その他[4]
回答数[5]	377	150	75	41	14	11
（参考）昨年度回答数[6]	347	149	78	36	18	6

[1]平成 27 年度までは、自由記入欄への回答を表 6 に記載されている観点に沿って分類していたところ、平成 28 年度から、過去の調査結果で回答数の多かった項目をチェックボックス化しています。

[2] 有効回答数は 616 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計しました。また、「他国の特許庁で審査を受けた経験がない／わからない」との回答は 33 件、「特に感じる点はない」との回答は、69 件ありました。

[3]有効回答数は 509 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計しました。

[4] 具体的には、独国特許商標庁について 2 件、シンガポール特許庁について 1 件、英国知的財産庁について 1 件、台湾特許庁について 1 件、オーストラリア特許庁について 1 件、ニュージーランド特許庁について 1 件の意見がありました。

[5]有効回答数は 615 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計しました。

1つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計しました。また、「他国の特許庁で審査を受けた経験がない／わからない」との回答は 31 件ありました。

[6]有効回答数は 552 件（「特に感じる点はない」の回答 347 件を含む）。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計しました。

表 8：日本国特許庁よりも他国の特許庁の方が優れていると感じる点

	回答数[1]				
	欧州特許庁	米国特許商標庁	中国国家知識財産権局	韓国特許庁	その他[2]
先行技術文献調査	82	19	13	2	4
拒絶理由通知書等の記載	25	32	11	5	1
新規性・進歩性等の判断	34	14	8	2	0
判断の均質性	7	2	0	0	0
審査官の技術理解力	10	2	0	1	0
審査のスピード	0	3	2	0	1
電話・面接等における審査官とのコミュニケーション	1	7	0	0	0
補正等の示唆	3	2	0	0	0
記載要件等の判断	3	3	3	2	0
その他[2]	17	6	4	1	1

表 8のとおり、欧州特許庁について、先行技術文献調査が優れているとする意見が多く見られました。これらの意見の具体的な内容としては、引用として提示される公報が特定の国に限られるものではない、非特許文献の調査も適切に実施されているとの意見がありました。

また、欧州特許庁及び米国特許商標庁について、論理付けに係る記載が丁寧である、下位請求項まで詳細に記載されている等、拒絶理由通知等の記載が丁寧であるという意見がありました。

[1] 有効回答数は 196 件（「特に感じる点はない」の回答は除く）。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計しました。

[2] 具体的には、欧州特許庁に対して「拒絶理由への反論の機会が多い」、米国特許商標庁に対して「権利範囲が広いクレームがとれる」などの意見がありました。

表 9 は、国内出願について日本国特許庁で審査結果が出されてから他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が新たに提示される頻度を問う設問の集計結果を示すものです。また、図 12 は、表 9 から「分からない／経験がない」という回答を除いた回答内容の割合を各庁毎に示したものです。

表 9：国内：他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が提示される頻度

	よく提示される	ときどき提示される	ほとんど提示されない	わからない／経験がない	計
米国特許商標庁	20	296	201	95	612
欧州特許庁	54	312	124	122	612
中国国家知識財産権局	16	180	307	109	612
韓国特許庁	7	86	302	217	612

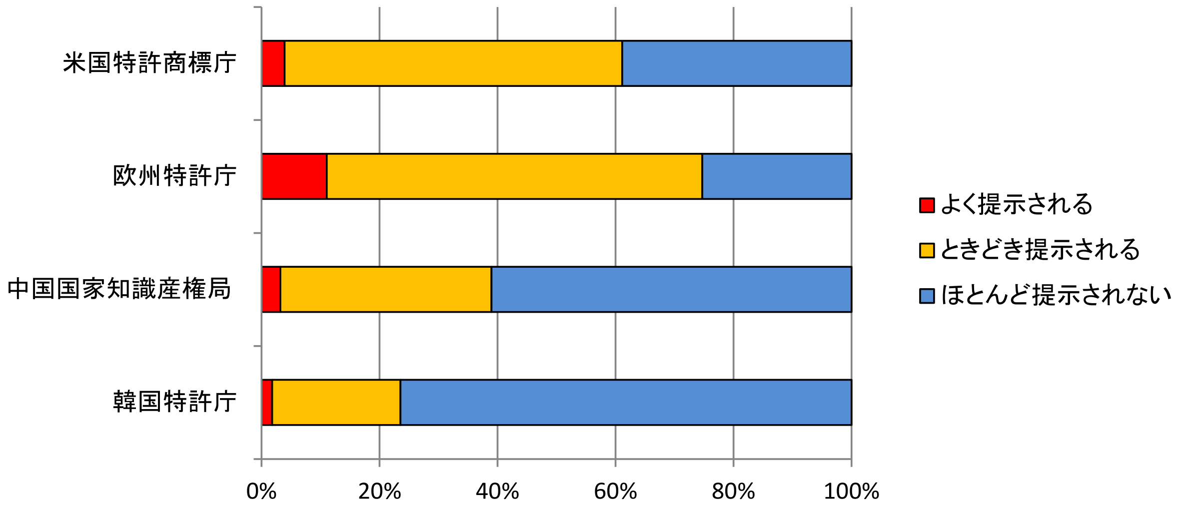

図 12：他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が提示される頻度（国内）

④ 自由記入欄への回答

調査票の自由記入欄には、新規性・進歩性等の判断に関する意見・要望が最も多く寄せられており、その数は 92 件でした。その他、拒絶理由通知等の記載のわかりやすさ（65 件）、判断の均質性（52 件）に関する意見・要望が多く寄せられておりました。

新規性・進歩性等の判断に関する意見・要望としては、進歩性の判断基準が甘いとの指摘が 39 件、周知技術や設計事項とする根拠が不足しているとの指摘が 18 件ありました。

拒絶理由通知等の記載のわかりやすさに関する意見・要望としては、引用文献の認定や一致点・相違点に関する記載が不足しているとの指摘が 16 件、下位請求項に対する拒絶理由の記載が不足しているという指摘が 11 件ありました。

判断の均質性に関する意見・要望としては、進歩性の判断の均質性が低いとの意見が 15 件、記載要件に関する判断の均質性が低いとの意見が 12 件ありました。

(2) PCT 出願における国際調査等の質について

① PCT 出願における国際調査等の質全般について

PCT 出願における国際調査等の質全般において、肯定的な回答の割合は、平成 24 年度の調査開始時より年々向上しています。

図 13 は、平成 24 年度の調査開始時からの PCT 出願の国際調査等の質全般に関する評価を示すものです。「満足」又は「比較的満足」と回答した割合は、本年度初めて 50%を超え、54．2%でした。この回答割合は、昨年度（48．4%）から約 6%増加していました。

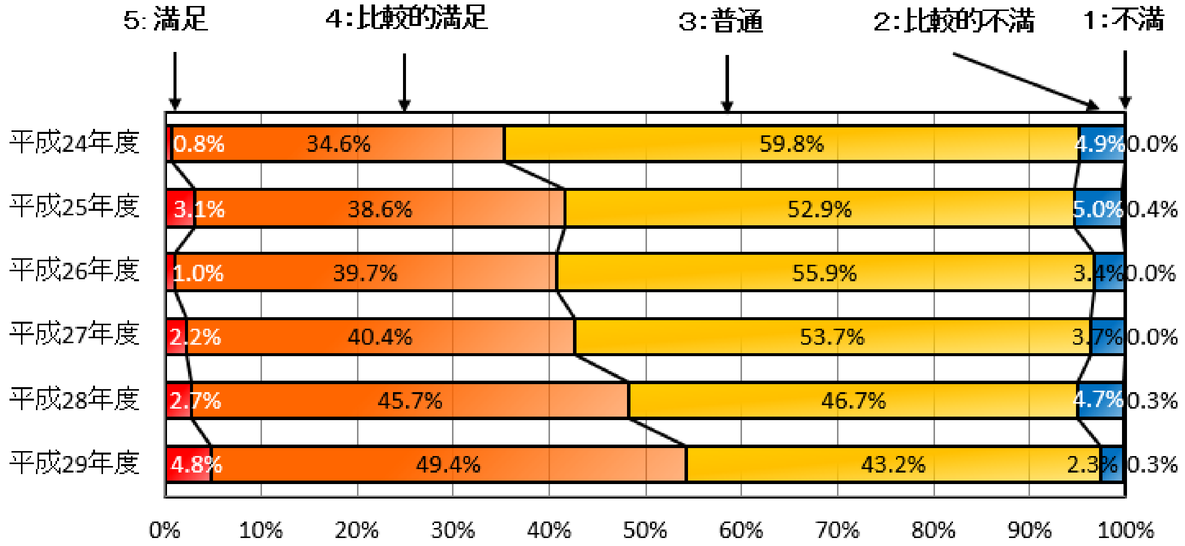

図 13：国際調査等の質全般の満足度

② 国際調査等の項目別の質の評価について

表 10は、項目別の評価件数を示したものです。また、図 14〜図 20は、「5：満足」〜「1：不満」の解答割合を項目別に示したものです[1]。

表 10：PCT出願の項目別回答数

質問項目		満足	比較的満足	普通	比較的不満	不満	分からない
国際特許分類の精度		30	122	131	2	0	25
除外対象に関する判断		17	32	78	3	0	180
単一性違反に関する判断		30	80	150	5	0	45
新規性・進歩性に関する判断		10	140	140	17	2	1
新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさ		16	142	136	14	1	1
記載不備等に関する判断		15	73	176	14	1	31
国際調査等における判断の均質性		9	84	189	21	0	7
国際段階と国際段階との間での判断の一貫性		24	102	129	41	2	12
サーチに関して	国内特許文献の調査	38	164	102	1	3	2
	外国特許文献の調査	6	70	162	45	9	18
	非特許文献等の調査	3	46	166	40	9	46

本年度の「国際特許分類の精度」等の国際調査等の質に関する設問について、「国内特許文献の調査」（65. 5%）、「国際特許分類の精度」（53. 3%）、「新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさ」（51. 2%）の 3 項目は、「満足」〜「不満」のうち、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が 50%以上を占めていました（図 14〜16）。

「外国特許文献の調査」の設問について、図 17 に示されるように、平成 24 年の調査開始時より「不満」又は「比較的不満」の割合に減少傾向が見受けられ、昨年度は、「不満」又は「比較的不満」の割合が 20%を下回りました。更に、「外国特許文献の調査」の項目に「満足」又は「比較的満足」と回答した割合は、昨年度から約 10%増加し、26. 1%でした。

「非特許文献等の調査」については、平成 24 年の調査開始時より「不満」又は「比較的不満」の割合に減少傾向が見受けられ、本年度は、「不満」又は「比較的不満」の割合が 20%を下回りました。他方で、当該項目は、他の項目と比べると「満足」または「比較的満足」と回答した割合が最も低く、18. 5%でした（図 18）。

「国際調査等における判断の均質性[2]」、「国際段階と国内段階との間での判断の一貫性[3]」について、過去 6 年間の経年変化でみると、改善傾向が見受けられます（図 19、20）。

---

[1] 「5:満足」〜「1:不満」の回答割合の経年変化を示すグラフでは、「わからない」、「無回答」の割合を除いています。

[2]平成 27 年度までは、「国際段階におけるばらつきのない判断」として調査していました。

[3]平成 27 年度までは、「国際段階と国内段階でのばらつきのない判断」として調査しておりました。

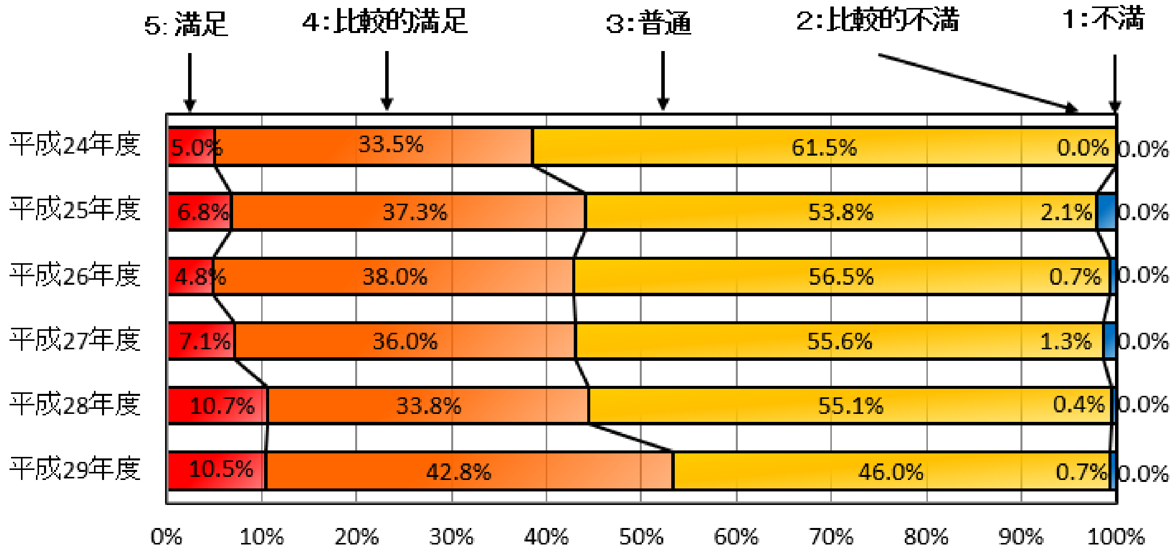

図 14：国際特許分類の精度の満足度

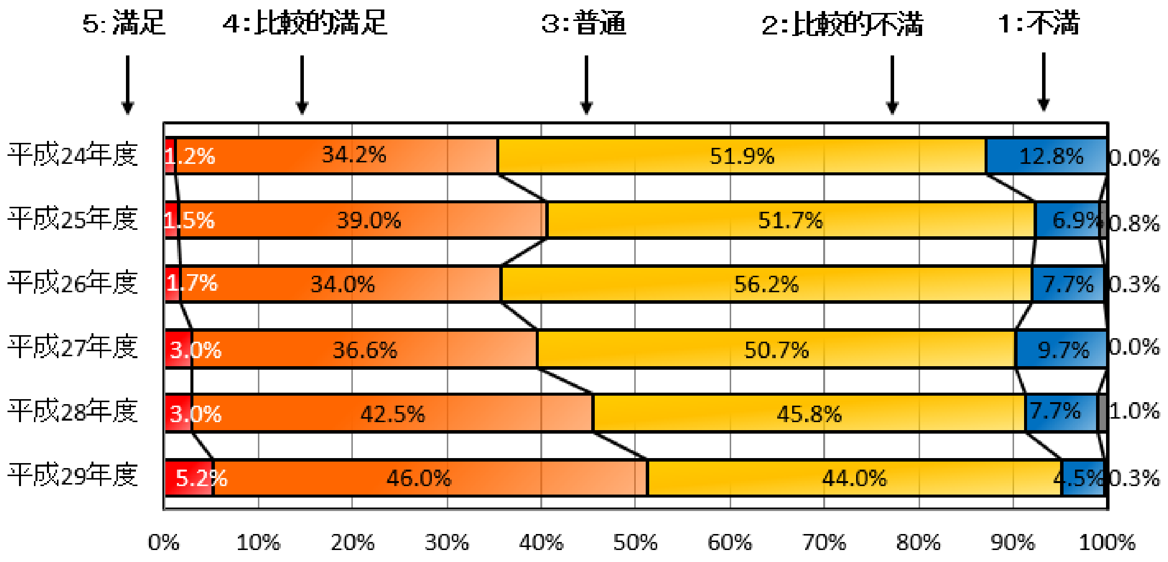

図 15：新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさの満足度

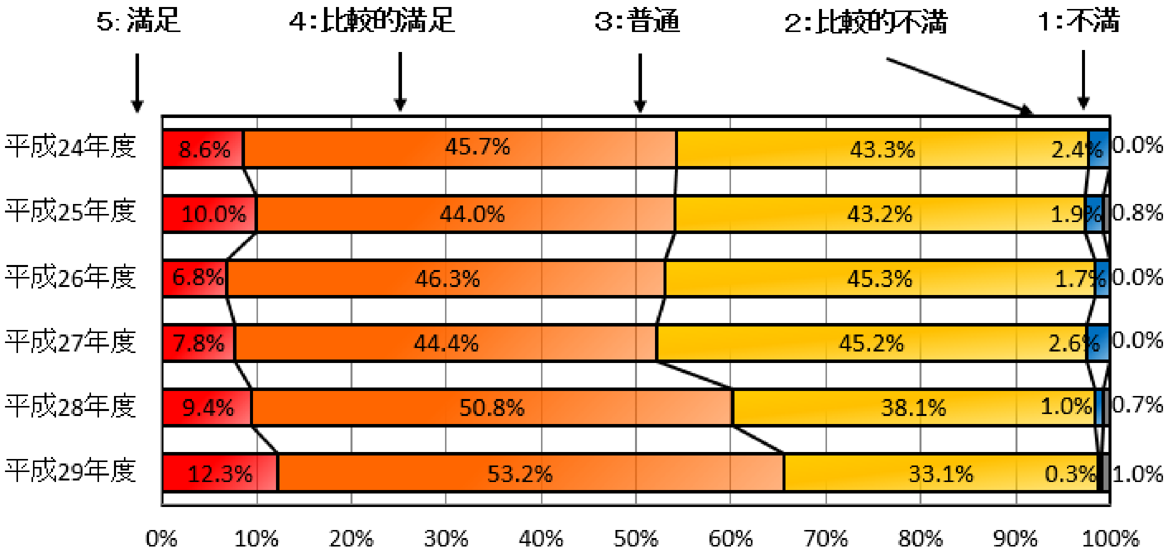

図 16：国際調査等での国内特許文献の調査の満足度

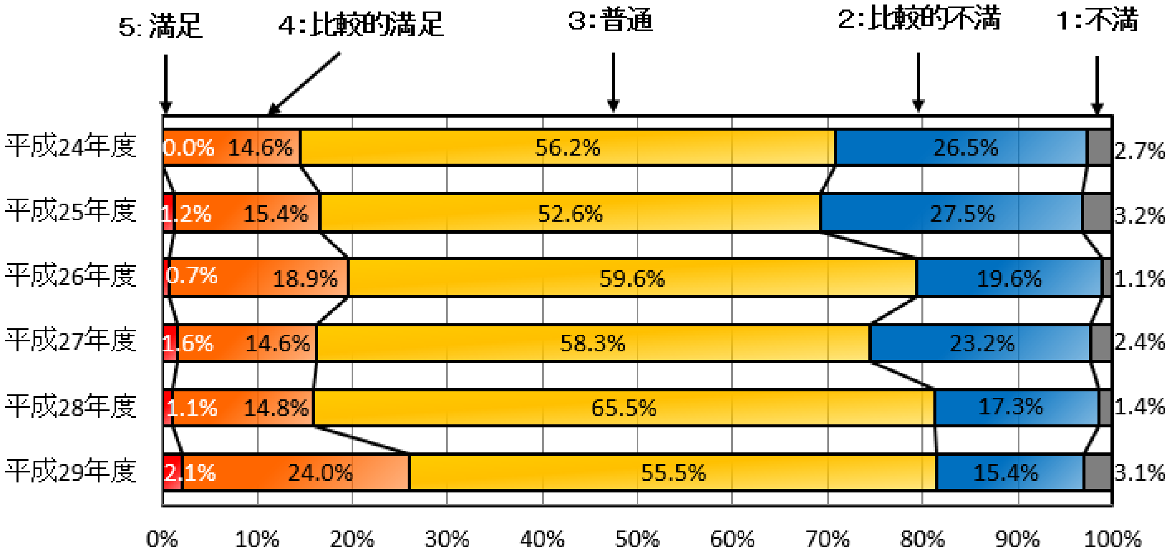

図 17：国際調査等での外国特許文献の調査の満足度

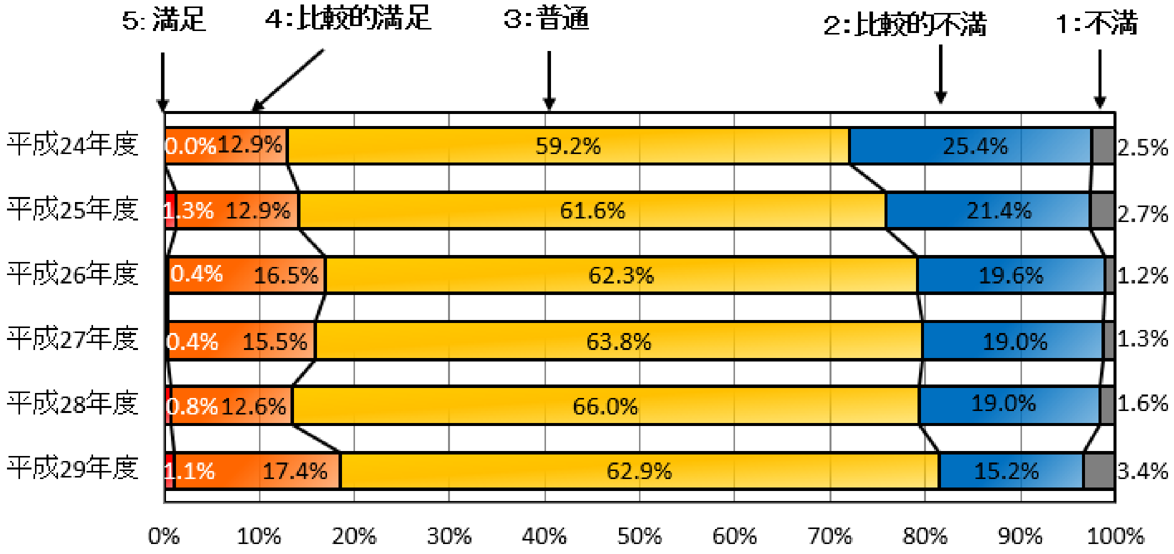

図 18：国際調査等での非特許文献等の調査の満足度

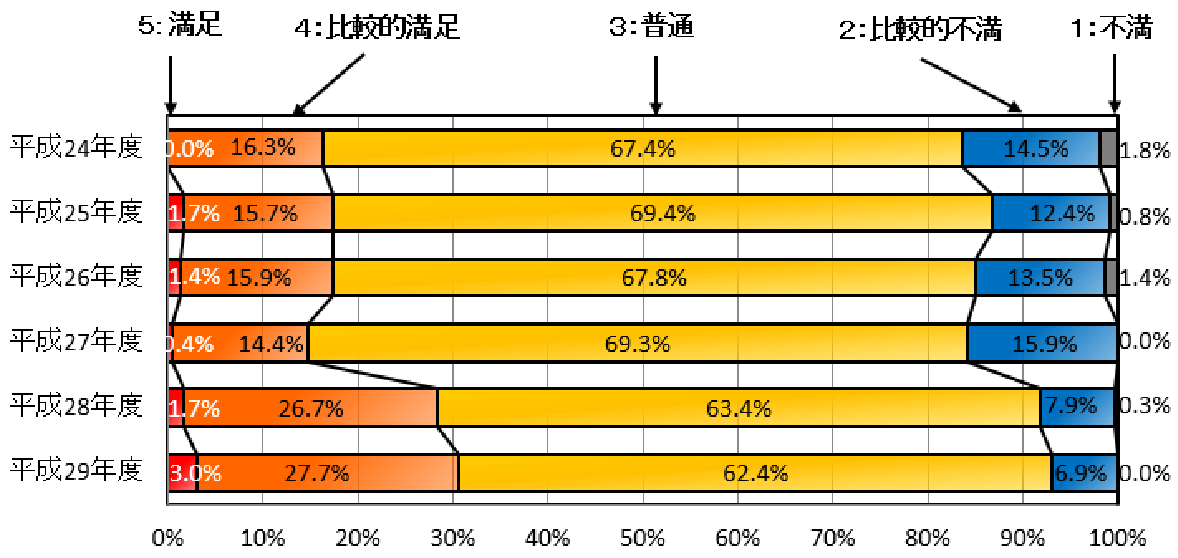

図 19：国際調査等における判断の均質性についての満足度

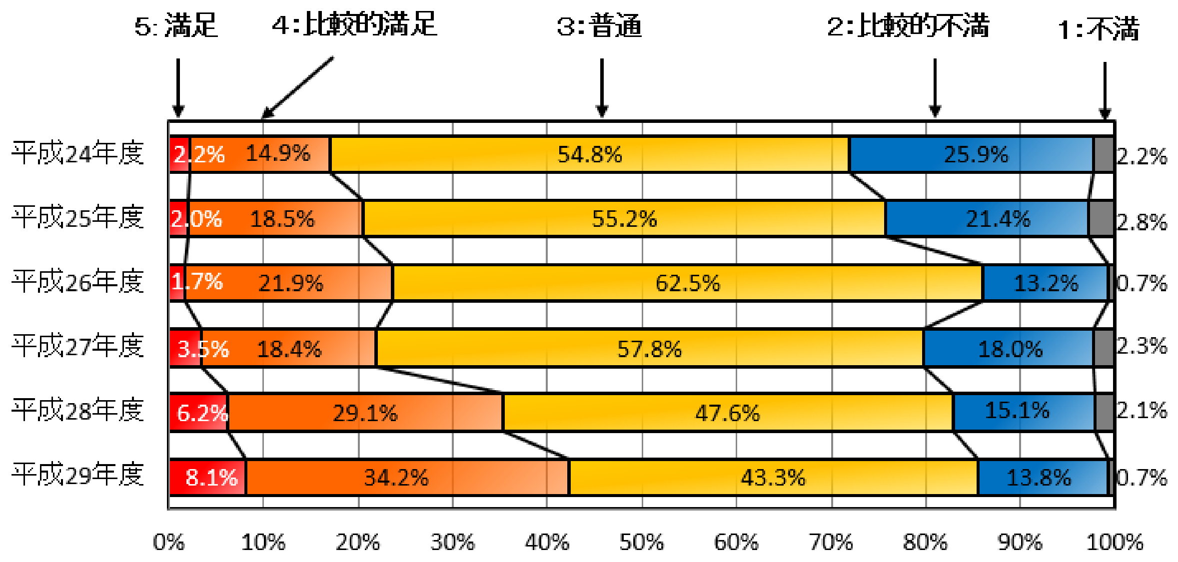

図 20：国際段階と国内段階との間での判断の一貫性の満足度

③ 他国庁との比較について

表 11 は、PCT 出願について日本国特許庁の国際調査機関としての見解を得てから各国の国内段階に移行したときに他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が新たに提示される頻度を問う設問の集計結果を示すものです。また、図 21 は、表 11 から「分からない／経験がない」という回答を除いた回答内容の割合を各庁毎に示したものです。

表 11：PCT：他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が提示される頻度

	よく提示される	ときどき提示される	ほとんど提示されない	わからない／経験がない	計
米国特許商標庁	28	179	83	20	310
欧州特許庁	50	173	50	37	310
中国国家知識財産権局	12	103	170	25	310
韓国特許庁	3	62	171	74	310

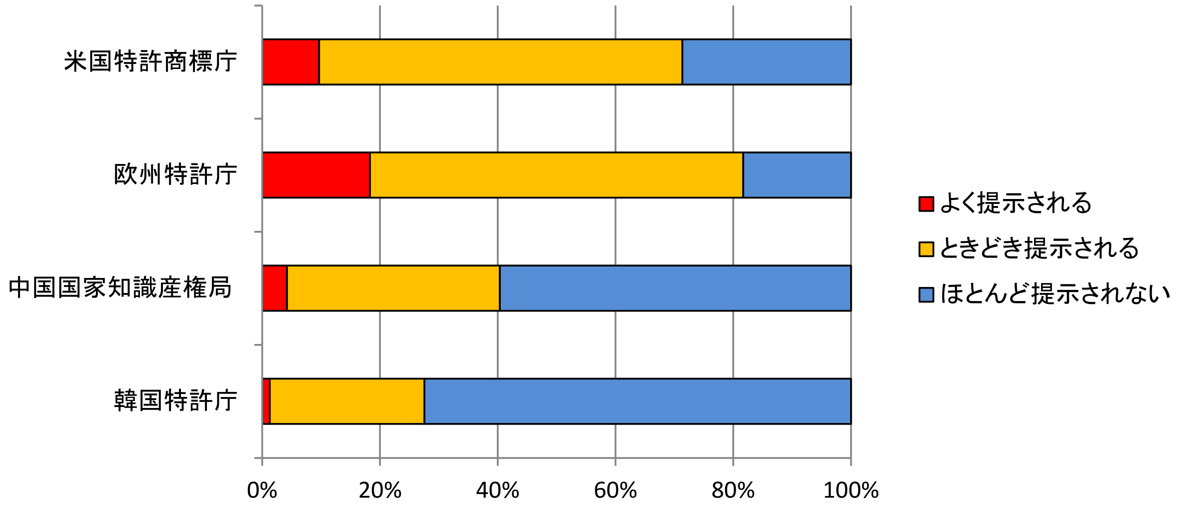

図 21：他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が提示される頻度（PCT）

④ 自由記入欄への回答

調査票の自由記入欄には、先行技術文献調査に関する意見・要望が最も多く寄せられており、その数は、40 件でした。そのうち、23 件は外国特許文献のサーチ、7 件は非特許文献のサーチに関する意見・要望でした。また、国際調査段階で得られた見解と、日本国特許庁の国内段階に入ったときの判断が相違する点（20 件）や国際調査段階で得られた見解と、海外特許庁の国内段階に入ったときの判断が相違する点（30 件）に関する指摘も多く寄せられました。

（3）特定の国内出願における特許審査の質について

① 調査対象案件における特許審査の質について（全般）

調査対象となった特定の国内出願における特許審査の質について、満足または比較的満足との肯定的な回答の割合は、56.5％でした。この肯定的な回答の割合を経年変化でみると、平成 24 年度の調査開始時より、55％付近を推移しております。

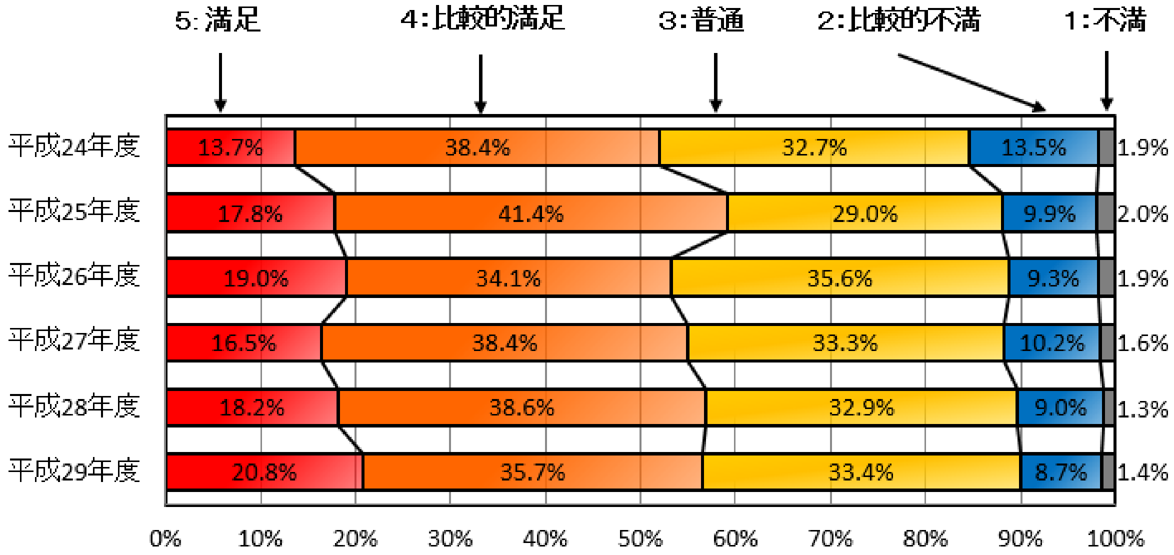

図 22：特定の国内出願における特許審査の質の満足度

表 12 は、図 22 に示される結果を、最終処分毎に分けた結果を示すものです。本年度も、特許査定＞戻し拒絶査定＞意見拒絶査定の順に、満足または比較的満足の肯定的な回答がなされた割合が高いことがわかりました。

なお、用語の意味は以下のとおりです。

「意見拒絶査定」：査定直前の拒絶理由通知に対し、出願人による意見書や手続補正書が提出され、これを受けて拒絶査定がなされたもの。

「戻し拒絶査定」：査定直前の拒絶理由通知に対し、出願人による意見書や手続補正書が提出されずに拒絶査定に到ったもの。

表 12：最終処分別での特定の国内出願における 5 段階評価

5 段階評価	意見拒絶査定	戻し拒絶査定	特許査定
5:満足	17 (7.7%)	11 (8.3%)	340 (24.1%)
4:比較的満足	60 (27.3%)	45 (34.1%)	525 (37.2%)
3:普通	79 (35.9%)	68 (51.5%)	442 (31.3%)
2:比較的不満	51 (23.2%)	7 (5.3%)	96 (6.8%)
1:不満	13 (5.9%)	1 (0.8%)	10 (0.7%)
合計	220	132	1413

② 調査対象案件における特許審査の質に肯定的な回答をした理由について

表 13 は、調査対象となった特定の国内出願における特許審査の質に肯定的な回答（5 段階評価で 5 又は 4）をした理由についての集計結果を示したものです。また、表 14 は、満足理由を最終処分毎に分類したものです。

表 13：国内の特定案件の質について、満足と回答した理由の集計結果

満足している理由	回答数[1]	（参考）昨年度回答数[2]
拒絶理由通知／拒絶査定の記載のわかりやすさ	656	651
新規性・進歩性に関する判断が適切である	618	609
サーチ範囲・サーチ結果が適切である	297	276
面接、電話等における審査官とのコミュニケーション	52	62

表 14：最終処分別での満足と回答した理由の集計結果

	拒絶理由通知／拒絶査定の記載のわかりやすさ	新規性・進歩性に関する判断が適切である	サーチ範囲・サーチ結果が適切である	面接、電話等における審査官とのコミュニケーション	その他
意見拒絶査定（77 件）	58	53	24	0	5
戻し拒絶査定（56 件）	45	40	16	0	3
特許査定（865 件）	553	525	257	52	108

[1] 有効回答数は 998 件。ただし、1つの回答に複数の理由が含まれる場合は意見ごとに集計しました。
[2] 有効回答数は 1013 件。ただし、1つの回答に複数の理由が含まれる場合は意見ごとに集計しました。

③ 調査対象案件における特許審査の質に否定的な回答をした理由について

表 15 は、調査対象となった特定の国内出願における特許審査の質に否定的な回答（5 段階評価で 2 又は 1）をした理由について、オフィスアクション別に集計した結果を示したものです。

不満内容の内訳は、「最初の拒絶理由通知」、「最後の拒絶理由通知」、「拒絶査定」いずれにおいても「新規性・進歩性を欠いている理由についての説明が十分でない」との指摘が多くの割合を占めていました。

表 15：特定案件の特許審査の質に不満がある理由

不満がある理由	回答数[*1]			
	最初の拒絶理由通知	最後の拒絶理由通知	拒絶査定	特許査定
拒絶理由通知／拒絶査定の記載のわかりやすさ	27	4	4	－
引用文献が必要以上に多く提示されている	7	3	4	－
新規性・進歩性を欠いている理由についての判断	100	17	49	－
記載要件（第 36 条 4 項 1 号、第 36 条 6 項）を満たしていないとする理由についての判断	24	7	5	－
単一性違反（第 37 条）に関する判断	1	0	0	－
判断の均質性	7	1	2	0
サーチ範囲・サーチ結果	8	1	1	1
面接、電話等における審査官とのコミュニケーション	3	1	0	0
その他	5	1	6	3

＊1　有効回答数は 178 件。ただし、1 つの回答に複数の理由が含まれる場合は指摘ごとに集計した。

(4) 特定の PCT 出願における国際調査等の質について

① 調査対象案件における国際調査等の質

調査対象となった特定の PCT 出願における国際調査等の質について、満足または比較的満足との肯定的な回答がなされた案件は 57. 8%（昨年度 53. 2%）でした。経年変化でみると、肯定的な見解の割合は、概ね 50%代で推移しております。

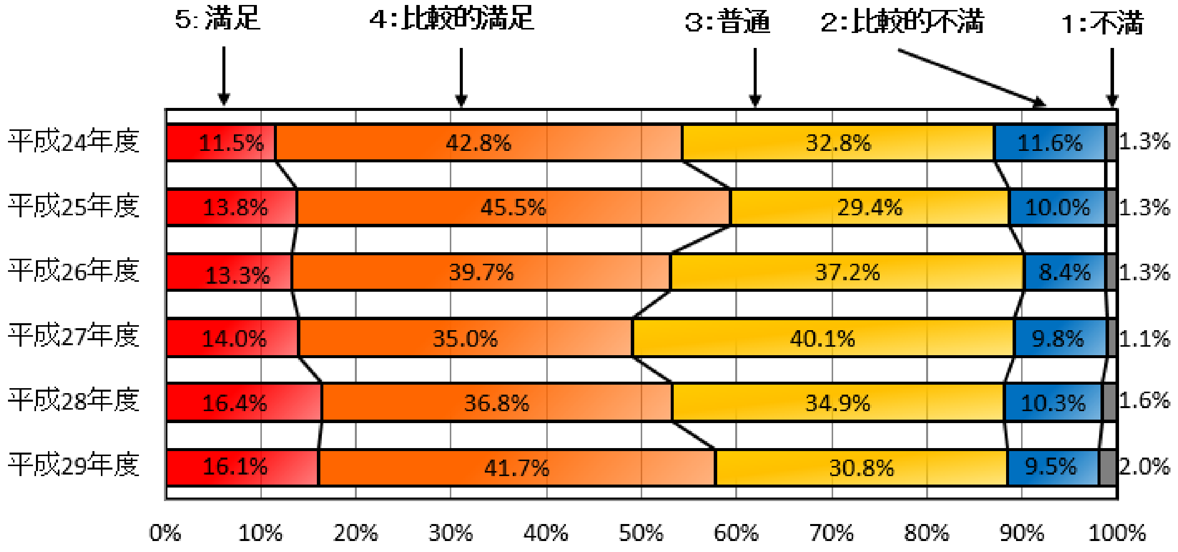

図 23：特定の PCT 出願における国際調査等の質の満足度

② 調査対象案件における国際調査等の質に肯定的な回答をした理由について

表　16 は、調査対象となった特定の PCT 出願に関する国際調査等の質について、「満足」又は「比較的満足」と回答した理由についての集計結果を示したものです。

表 16：PCT 特定案件の質（満足と回答した理由の集計結果）

満足している理由	回答数 [1]	（参考）昨年度回答数 [2]
国際調査報告・見解書等の記載のわかりやすさ	252	234
新規性・進歩性に関する判断が適切である	254	243
サーチ範囲・サーチ結果が適切である	154	150

[1] 有効回答数は 384 件。ただし、1つの回答に複数の理由が含まれる場合は意見ごとに集計しました。
[2] 有効回答数は 363 件。ただし、1つの回答に複数の理由が含まれる場合は意見ごとに集計しました。

③ 調査対象案件における国際調査等の質に否定的な回答をした理由について

表 17 は、調査対象となった特定の PCT 出願における国際調査等の質に否定的な回答（5 段階評価で 2 又は 1）をした理由について、国際調査段階と国際予備審査段階との段階別に集計した結果を示したものです。

不満内容の内訳は、国際調査段階（国際調査報告書・国際調査機関の見解書）において、「新規性・進歩性を欠いている理由についての判断」との指摘が多くの割合を占めていました。

表 17 : 特定案件の国際調査等の質に不満がある理由

不満がある点	回答数[*1]	
	国際調査報告書･国際調査機関の見解書	国際予備調査報告書
国際調査報告・見解書等の記載のわかりやすさ	11	0
引用文献が必要以上に多く提示されている	7	1
新規性・進歩性を欠いている理由についての判断	65	1
記載不備等と判断した理由についての判断	1	0
単一性違反に関する判断	1	0
判断の均質性	4	0
サーチ範囲・サーチ結果	8	0
その他	5	0

*1　有効回答数は 76 件。ただし、1 つの回答に複数の理由が含まれる場合は指摘ごとに集計した。

3. 回答内容の詳細分析

(1) 各評価項目と全体評価との相関分析

① 分析の内容

特許審査に対する評価（満足度）の向上に向けて、どのような点に優先的に注力するべきか把握するため、各個別の評価項目（「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」等）の評価が、質全般への評価（全体評価）に対して与える影響について調査しました。

このような影響の強さは、一般の顧客満足度調査においてもよく行われるとおり、全体評価（特許審査の質全般に対する 5 段階評価）と、各個別の評価項目の評価（項目別の 5 段階評価）との間の相関係数の大きさにより分析することができます。

図 24 は、個別の評価項目（拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ）の評価と、全体評価との関係を示した例です。円の大きさは当該評価の回答件数、実線は回帰直線を表しています。

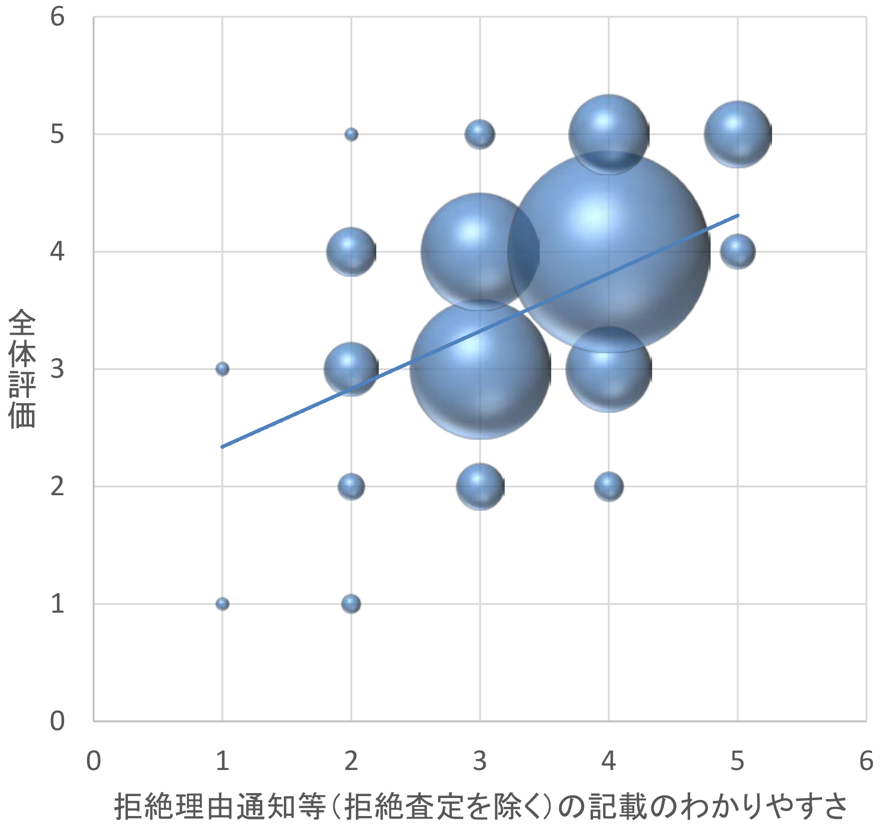

図 24：個別の評価項目の評価と全体評価の関係

② 個別の項目への評価の全体評価への影響（国内出願）

国内出願における特許審査の質全般を問う調査票（A 票）の各個別の評価項目（「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」等）の評価が、質全般への評価（全体評価）に与える影響について調査しました。このような影響の強さは、全体評価（特許審査の質全般に対する 5 段階評価、5：満足～1：不満）と、各個別の評価項目の評価（項

目別の 5 段階評価、5：満足～1：不満）との間の相関係数で分析することができます。

図 25 は、国内出願全般について、この相関係数と、各個別の評価項目の評価の平均との関係を示したものです。図中、特に、現在の評価が低く、全体評価との相関係数が大きい項目（図中の左上の位置する項目）について、優先的に改善・向上を図ることが有益だと考えられます。

「判断の均質性」は、全体との相関が高く、評価の平均も各項目の中で相対的に低いため、優先的に改善に取り組む必要がある項目です。また、「外国特許文献の調査」、「非特許文献等の調査」は、全体評価との相関は高くありませんが、評価の平均は、各項目の評価の中で相対的に低い項目です。

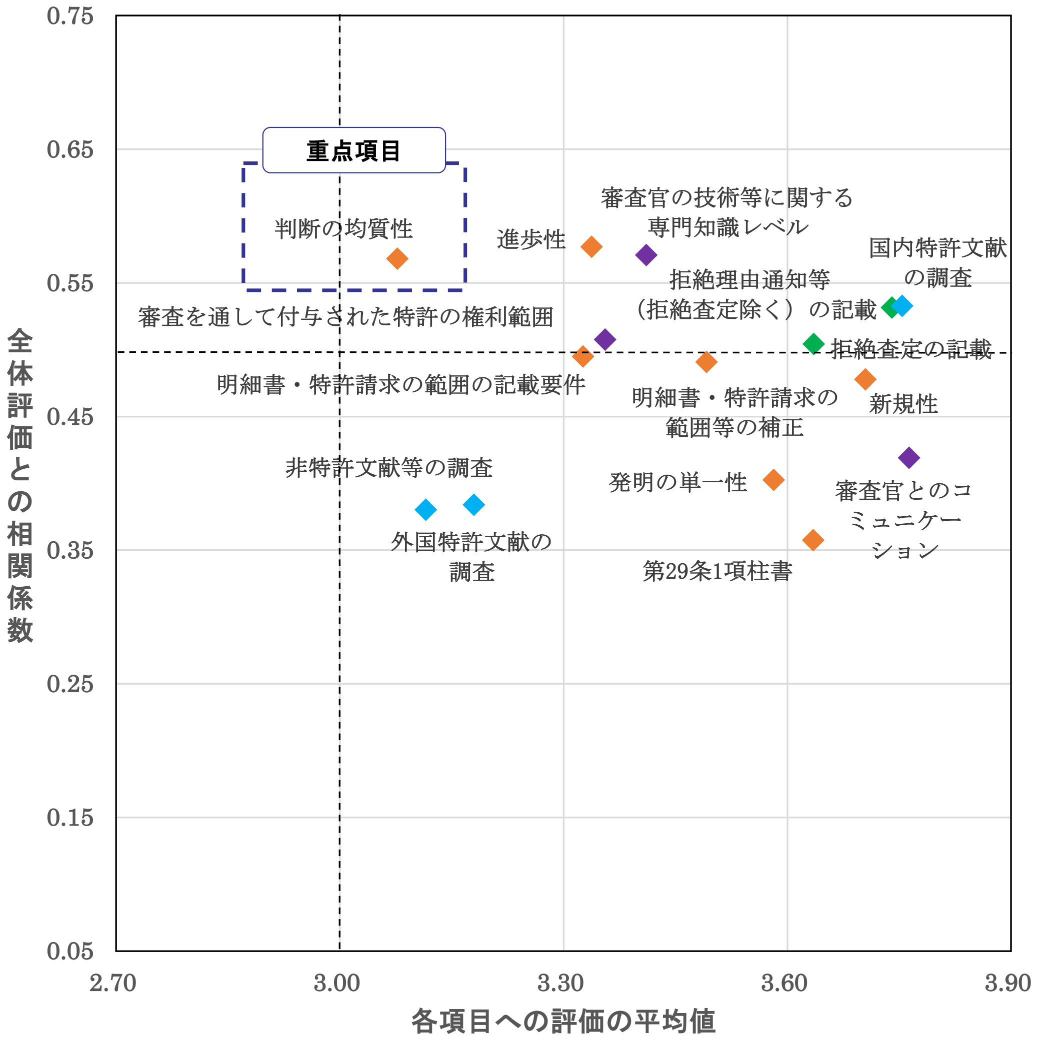

図 25：各評価項目の評価の平均値と、全体評価との相関係数（国内出願）[1]

[1] 図中のマーカの色は、水色がサーチに関する項目、橙色が判断に関する項目、緑色が通知書等の記載に関する項目、紫色がその他の項目であることを示します。

図 26 は、昨年度の評価の平均値、全体評価との相関係数から変化を示す矢印を併記したものです。個別項目のなかで、「判断の均質性」、「外国特許文献の調査」、「非特許文献等の調査」、「明細書、特許請求の範囲の補正」、「発明の単一性」が相関係数の増加が比較的大きかった項目です。

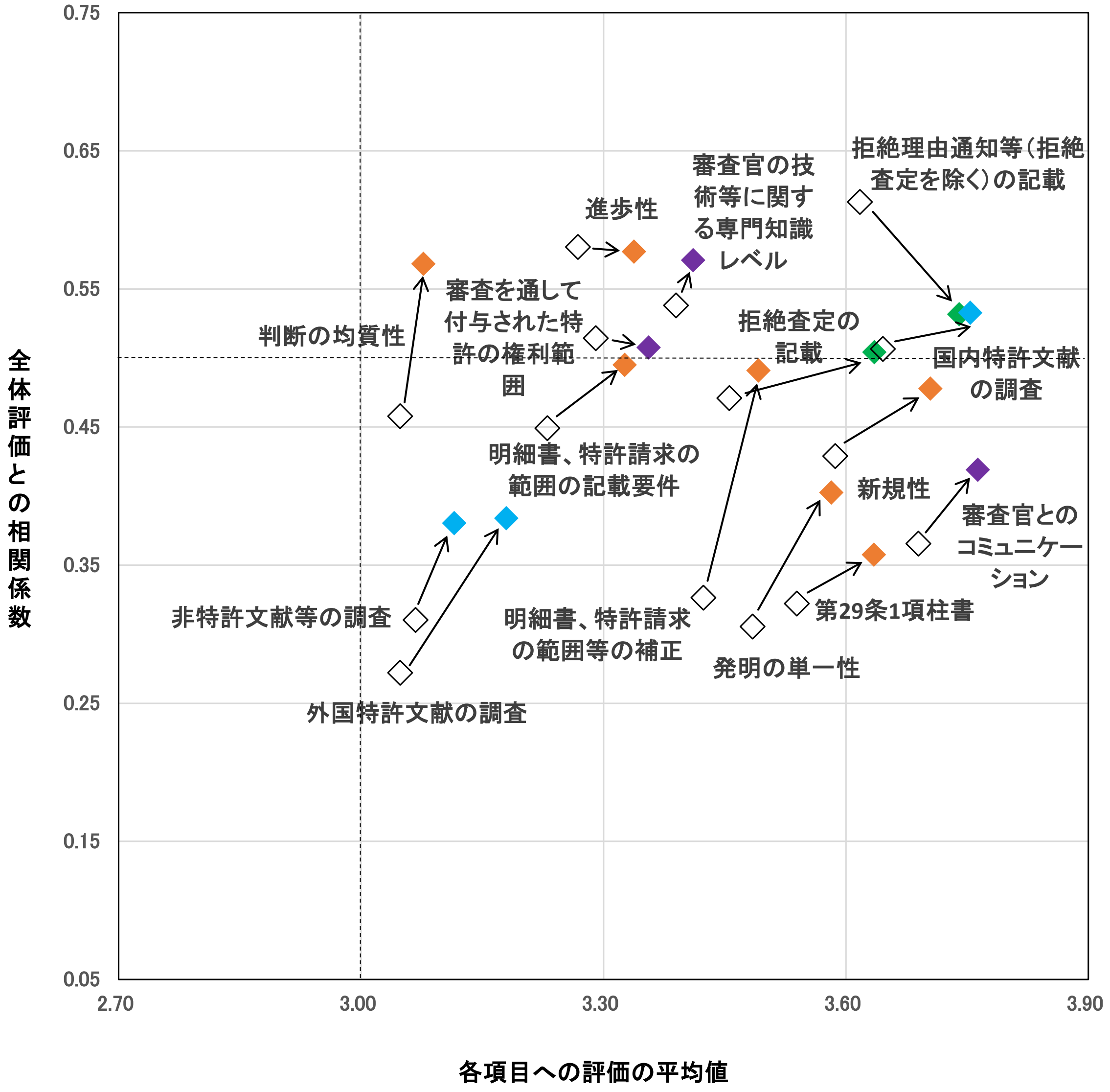

図 26：全体評価に対する相関・評価の平均の変化（国内出願）[1]

[1] 図中のマーカの色は、水色がサーチに関する項目、橙色が判断に関する項目、緑色が通知書等の記載に関する項目、紫色がその他の項目であることを示します。

個別の項目への評価の全体評価に対する影響（PCT 出願）

PCT 出願における国際調査等の質全般を問う調査票（C 票）の各個別の評価項目（「国際特許分類の精度」等）の評価が、質全般への評価（全体評価）に与える影響について調査しました。このような影響の強さは、全体評価（国際調査等の質全般に対する 5 段階評価、5：満足～1：不満）と、各個別の評価項目の評価（項目別の 5 段階評価、5：満足～1：不満）との間の相関係数で分析することができます。

図 27 は、PCT 出願全般について、各評価項目の評価の平均と全体評価との相関係数を示すものです。

「外国特許文献の調査」、「非特許文献の調査」での評価の平均は、各項目の評価の平均において相対的に低い項目です。

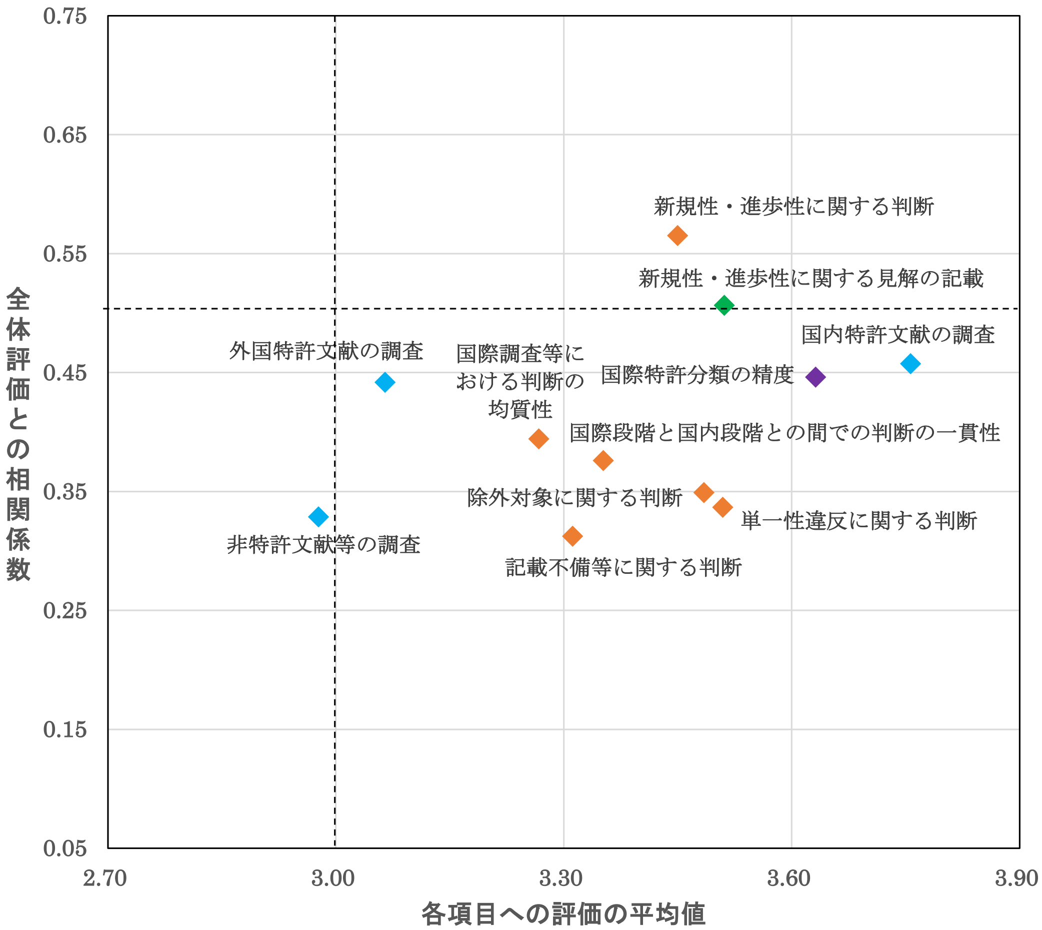

図 27：各評価項目の評価の平均値と、全体評価との相関係数（PCT 出願）[1]

[1] 図中のマーカの色は、水色がサーチに関する項目、橙色が判断に関する項目、緑色が通知書等の記載に関する項目、紫色がその他の項目であることを示します。

図 28 は、昨年度の評価の平均値、全体評価との相関係数から変化を示す矢印を併記したものです。全項目の中で評価の平均値が低かった外国特許文献の調査、非特許文献等の調査については、全体評価との相関係数が昨年度と比べ上がっており、質全般への評価（全体評価）に与える影響が大きくなったことがわかりました。

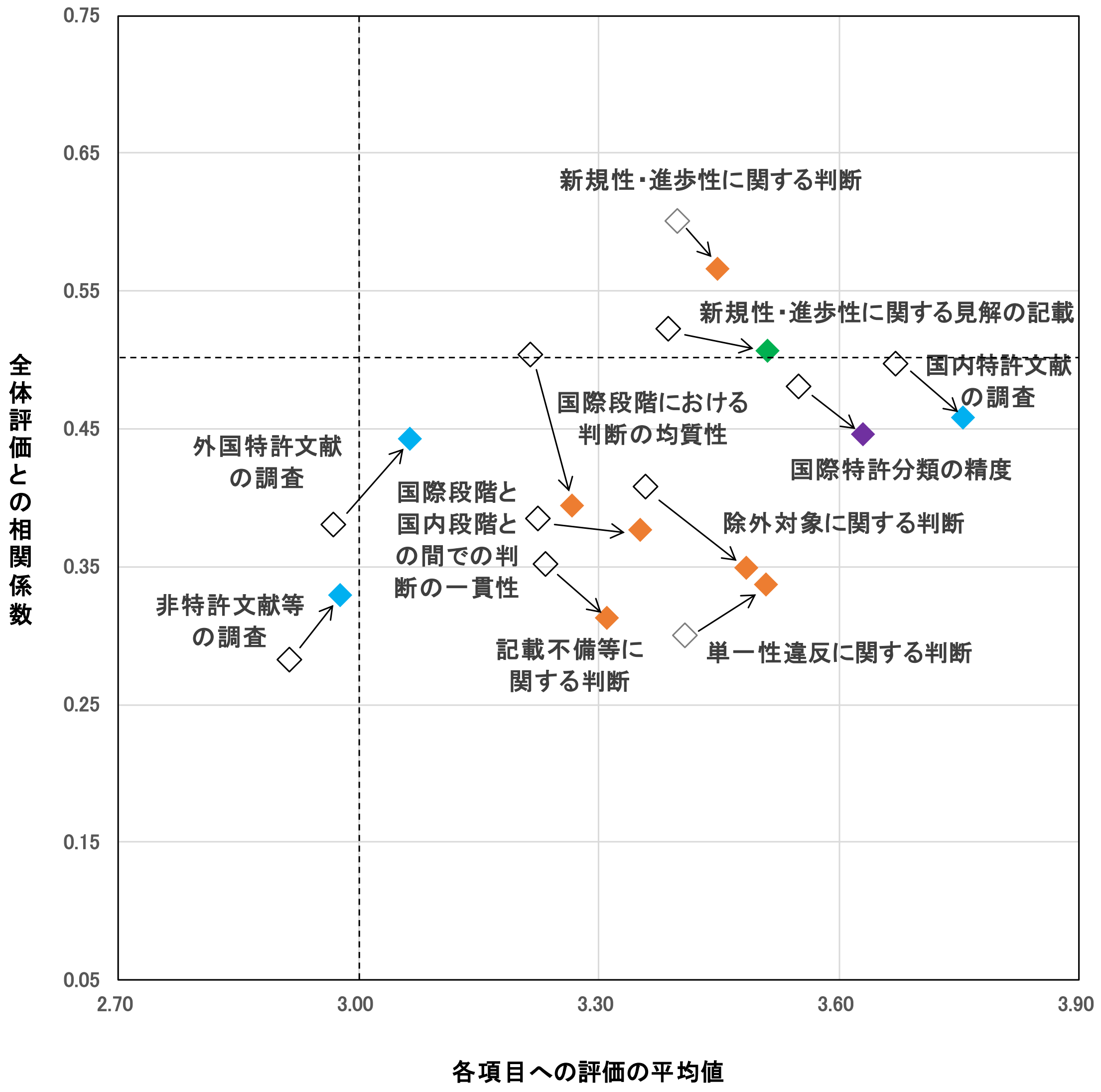

図 28：全体評価に対する相関・評価の平均の変化（PCT 出願）[1]

[1] 図中のマーカの色は、水色がサーチに関する項目、橙色が判断に関する項目、緑色が通知書等の記載に関する項目、紫色がその他の項目であることを示します。

（2）個別案件の具体的に不満があるとされた事項の分析について

ユーザーからは、調査の対象となった特定案件に対する意見のほか、自由記載の回答により、特許審査の手続や質に問題があったと思われる案件について意見として、121 件の国内出願が挙げられました。これらの案件に対する不満の内容について、B 票、D 票において、特許審査の質に否定的な回答がなされた特定の出願への不満内容とあわせて分析を行いました。

① 分析の内容

上記のとおり、特許審査の手続や質に問題があったとして自由記載により回答された案件と、特定の出願に対し特許審査の質に否定的な回答がなされた案件について、具体的な不満の内容を分析しました（自由記載案件：国内出願 121 件、特定の出願：国内出願 178 件、PCT 出願 76 件、合計 375 件）。

この分析では、回答の内容について検討し、具体的に不満とされた事項を図 29 に示す＃01－＃21[1]のいずれかに分類しました。

[1] 平成 27 年度までは、57 の観点に沿って指摘事項を分類しておりましたが、平成 28 年度度の B 票、D 票の改訂に伴い、観点を統廃合しました。そのため、平成 28 年度、平成 29 年度と平成 27 年度までの比較においては、平成 27 年度までの対応する観点に分類された指摘件数を足し合わせています。

・新規性・進歩性に関する不満
#01　引用文献の認定
#02　一致点・相違点についての判断
#03　組合せ・動機づけについての判断
#04　下位請求項に対する判断
#05　その他
・記載要件に関する不満
#06　サポート要件に関する判断
#07　実施可能要件に関する判断
#08　明確性要件に関する判断
#09　プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームに関する判断
#10　その他
・判断の均質性に関する不満
#11　同一技術分野内での判断の相違
#12　異なる技術分野間での判断の相違
#13　審査・審判間の判断の相違
#14　他国特許庁との相違
#15　その他
・サーチに関する不満
#16　外国特許文献の調査
#17　非特許文献の調査
#18　国内特許文献の調査
#19　他国特許庁の調査結果との違い
#20　その他
・その他
#21

図 29：不満とされた事項の分類項目一覧

② 不満内容全体としての傾向

図 30 は、調査の対象となった特定案件全件及び自由記載の回答により特許審査の手続や質に問題があったと思われる案件全件に対する、新規性・進歩性、記載要件、均質性、サーチに対して不満とされた案件の割合を示したものです。特に新規性・進歩性に関する不満が多いことが分かりました

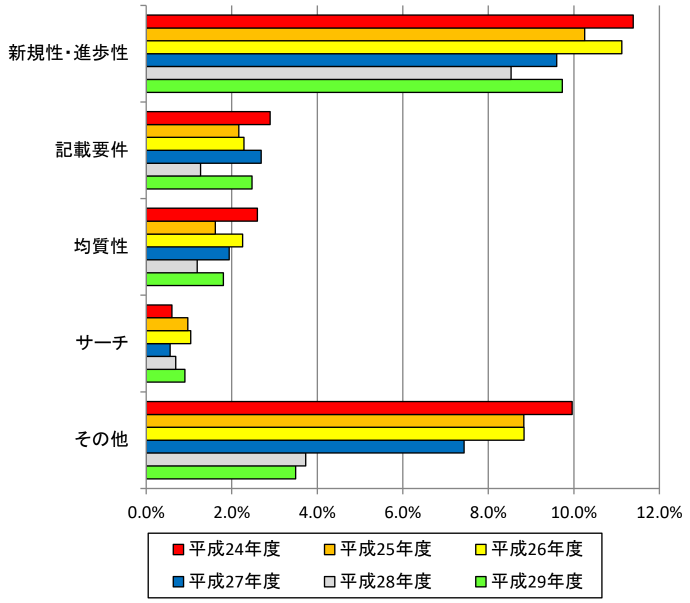

図 30：質に関して不満とされた率の経年変化とその内容の内訳

③ 新規性・進歩性に関する不満について

図 31 は、図 30 における新規性・進歩性に関して不満とされた理由の内訳です。

新規性・進歩性に関する不満については、「引用文献の認定」、「一致点、相違点の判断」、「組合せ・動機づけについての判断」の項目において、不満が多いことがわかりました。

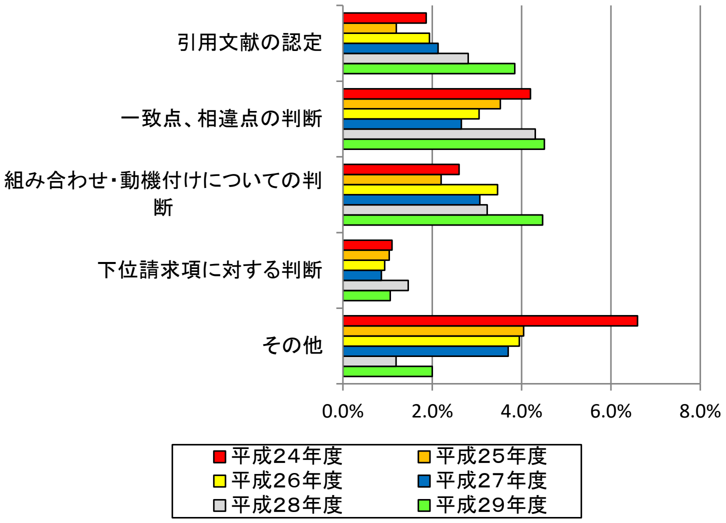

図 31：新規性・進歩性に関して不満とされた理由の内訳

④ 記載要件に関する不満について

図 32 は、図 30 における記載要件（36 条）に関して不満とされた理由の内訳です。

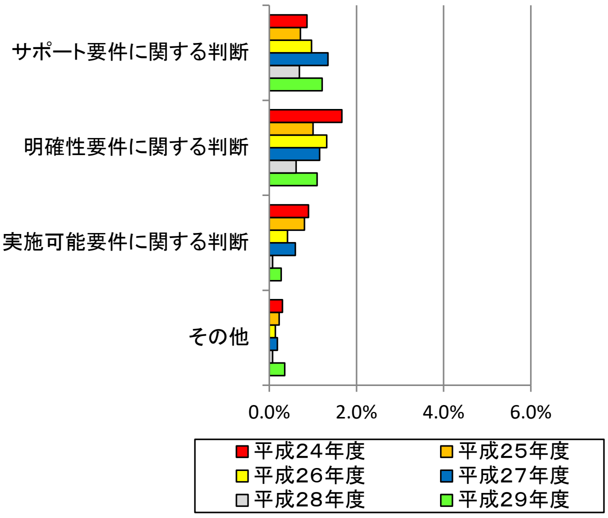

図 32：記載要件に関して不満とされた理由の内訳

⑤ 判断の均質性に関する不満について

図 33 は、図 30 における判断の均質性に関して不満とされた理由の内訳です。本年度は、同一技術分野内・異なる技術分野間での判断の相違に関する不満が多く寄せられました。

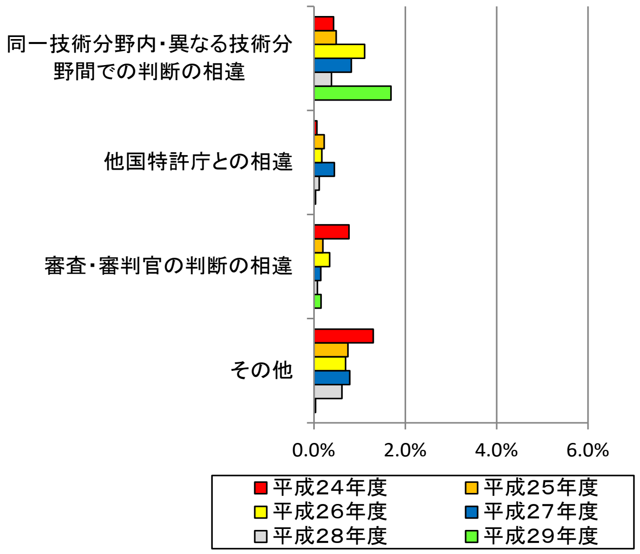

図 33：審査の判断の均質性に関して不満とされた理由の内訳

⑥ サーチに関する不満について

図 34 は、図 30 におけるサーチに対して不満とされた理由の内訳です。

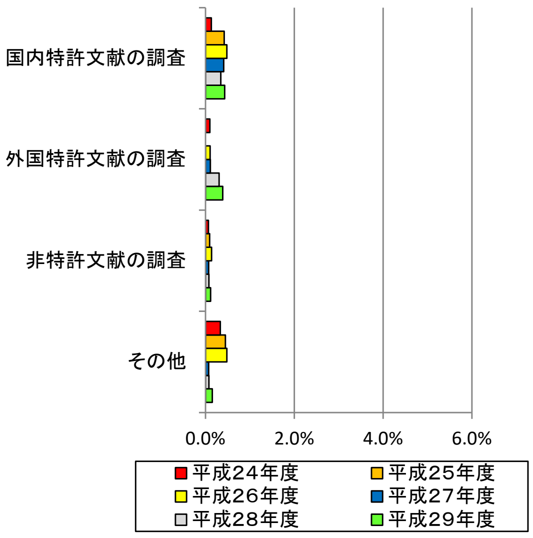

図 34：サーチに関して不満とされた理由の内訳

4. 分析結果のポイント

国内の特許審査における質全般（調査票Ａ票）について、「満足」又は「比較的満足」の肯定的な回答の割合は調査開始より年々増加し、平成29年度は、58.3%でした。

国内の特許出願の質に関する個別の項目（「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」等）に対する評価では、各項目への評価は概ね向上しておりました。特に、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が60%以上を占める、高評価の項目は、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」(67.3%)、「国内特許文献の調査」（65.7%)、「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション」(62.1%）でした。この中でも特に、「拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ」の項目では、「満足」又は「比較的満足」の割合が、平成24年の調査開始時から、30%以上向上していました。また、「判断の均質性について」の項目では、依然として「比較的不満」又は「不満」と回答した割合が20%以上を占めていたものの、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合は、着実な改善傾向が見受けられました（第6～15頁参照)。

PCT出願における国際調査等の質全般（調査票Ｃ票）においても、「満足」又は「比較的満足」の肯定的な回答の割合が調査開始より年々向上し、本年度は初めて半数を超え、54.2%にまで向上していました。

PCT出願の質に関する個別の項目（「国際特許分類の精度」等）に対する評価では、各項目への評価は概ね向上しておりました。特に、「国内特許文献の調査」(65.5%)、「国際特許分類の精度」(53.3%)、「新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさ」(51.2%）の3項目は、「満足」～「不満」のうち、「満足」又は「比較的満足」と回答した割合が50%以上を占めていました。また、「外国特許文献の調査」の項目については、否定的な回答の割合には昨年度からの変化が見受けられなかったものの、肯定的な回答の割合が15.9%から26.1%にまで向上していました（第16～22頁参照)。

これらのことから、特許庁でこれまで取り組んできた、審査の質向上のための取組が、着実にユーザーの評価に結びついていると考えられます。

さらに、調査票Ｂ票・Ｄ票において、調査の対象となった特定案件や、自由記載の回答により、特許審査の手続や質に問題があったと思われる案件に対する不満の内容について、分析を行ったところ、特に新規性・進歩性に関する不満が多いことが分かりました。また、同一技術分野内・異なる技術分野間での判断の相違は、本年度、不満とされた率が比較的高く、増加傾向にありました。このことから、調査票Ａ票の国内の特許出願の質に関する個別の項目において、比較的評価が低かった判断の均質性について、個別案件においても不満とされた率が増加していることが分かりました(第33～37頁を参照)。

今後は、これまでの審査の質向上のための取組を着実に実施しつつ、今回のユーザー評価調査における、全体評価に対する個別項目の評価の影響に係る分析結果や(第28～32頁を参照)、特許庁で実施している他の分析結果を踏まえて、総合的な視点から課題・改善点の抽出を行い、今回抽出された判断の均質性等の課題の改善に取り組んで行く必要があります。

本調査を通して把握される改善状況は、今後も本調査を継続し、その結果を報告することを通じてユーザーにお知らせしていく予定です。また、併せて特許庁における品質管理

の実施体制や実施状況等についてもホームページ等を通じて公表して参ります。

5. 今後のユーザー評価調査に向けて

本調査は、平成 24 年度から今年度まで同様の規模（今年度は、ユーザー725 者を対象としました）で調査を実施され、例年、概ねの回答率で回答が得られており、ユーザーからご理解をいただくと共に、積極的にご協力いただいています。

平成 29 年度の調査では、ユーザーが日本国特許庁の先行技術調査結果を外国庁と比較した場合にどのように評価しているかを検証するため、外国庁でより適切な引用文献が提示された頻度を問う設問を追加しました。

ユーザーニーズの継続的な把握のため、平成 30 年度以降もユーザーによる品質評価の手法の改善を図りつつ同様の調査を継続する予定です。今後の調査にあたっては、実施時期や実施方法、調査対象案件や調査対象者の選定方法、調査票の内容等について、更なる改善に向けて検討していきます。

なお、特許庁では、産業構造審議会の知的財産分科会に設けられた審査品質管理小委員会を設置し、審査品質管理の実施体制、実施状況の改善点等について議論していますが、本調査の結果は、その基礎としても活用されます。

謝辞

本調査の実施にあたりましては、多くのユーザーの皆様のご協力をいただきました。ここに、心より感謝の意を表します。

審査の質の維持・向上のためには、ユーザーの皆様による審査の品質評価を継続し、その結果に基づいて、特許審査及びその関連業務の継続的な改善を推進して行くことが必要です。引き続きのご協力をお願い致します。

（付録）調査票（A－D 票）

【Ａ票】　国内出願における特許審査の質全般について

＊記名または無記名のいずれの回答を希望するかご回答ください。

- ○　記名で回答する
- ○　無記名で回答する

＊無記名での回答は、メールアドレス等により回答者が特定される場合であっても、無記名でいただいた回答として集計いたします。

お名前		ご連絡先（TEL）	

＊ご回答者のお名前、ご連絡先をご記入の上（記名でのご回答を希望された場合のみ）、
下記【１】～【２】の問いに**最近（１年程度）のご経験に基づいて**お答えください。
＊なお、ご回答いただいた内容につき、頂いた連絡先に確認の連絡をさせていただくことがございます。

【１】特許審査の質一般について

	満足 5	比較的満足 4	普通 3	比較的不満 2	不満 1
①最近(１年程度)の特許審査の質全般についてどのように感じていますか。	○	○	○	○	○

②最近（１年程度）の特許審査の質に関し、
各項目１～１１の評価についてお答えください。

	満足 5	比較的満足 4	普通 3	比較的不満 2	不満 1	わからない／経験がない
１．拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさ	○	○	○	○	○	○
２．拒絶査定の記載のわかりやすさ	○	○	○	○	○	○
３．条文の運用に関して						
３－１．第29条1項柱書（産業上の利用可能性、「発明」に該当するか否かの判断）	○	○	○	○	○	○
３－２．第29条1項各号（新規性）	○	○	○	○	○	○
３－３．第29条2項（進歩性）	○	○	○	○	○	○
３－４．第36条4項1号、第36条6項（明細書・特許請求の範囲の記載要件）	○	○	○	○	○	○
３－５．第37条（発明の単一性）	○	○	○	○	○	○
３－６．第17条の2第3項～6項（明細書、特許請求の範囲等の補正）	○	○	○	○	○	○
４．判断の均質性について	○	○	○	○	○	○
５．サーチに関して						
５－１．国内特許文献の調査	○	○	○	○	○	○
５－２．外国特許文献の調査	○	○	○	○	○	○
５－３．非特許文献等の調査	○	○	○	○	○	○
６．審査官の技術等に関する専門知識レベル	○	○	○	○	○	○
７．面接、電話等における審査官とのコミュニケーション	○	○	○	○	○	○
８．審査を通して付与された特許の権利範囲について（出願の開示や先行技術との対比において、十全な権利範囲となっているか）	○	○	○	○	○	○

９．　特許審査の質に関し、他国の特許庁よりも日本国特許庁の方が優れていると感じる点があれば、
下記から選択してください。（複数可）
また、他国の特許庁より優れていると感じる点が特にない場合には、「特に感じる点はない」をチェックしてください。

- ☐ 先行技術文献調査
- ☐ 拒絶理由通知等の記載のわかりやすさ
- ☐ 新規性・進歩性等の判断
- ☐ 審査官の技術理解力
- ☐ 電話、面接等における審査官とのコミュニケーション
- ☐ その他（下記記入欄にご記入ください）
- ☐ 他国の特許庁で審査を受けた経験がない／わからない
- ☐ 特に感じる点はない

（９．に関する自由記入欄）

１０．特許審査の質に関し、日本国特許庁よりも他国の特許庁の方が優れていると感じる点があれば、
その特許庁にチェックを入れ（複数可）、優れていると感じた点を記入欄に記入してください。
また、他国の特許庁の方が優れていると感じる点が特にない場合は、「特に感じる点はない」に
チェックを入れてください。

- ☐ 米国特許商標庁（USPTO）
- ☐ 欧州特許庁（EPO）
- ☐ 中国国家知識産権局（SIPO）
- ☐ 韓国特許庁（KIPO）
- ☐ その他（国名も記入欄に記載してください）
- ☐ 他国の特許庁で審査を受けた経験がない／わからない
- ☐ 特に感じる点はない

（１０．に関する自由記入欄）

１１．日本と他の国／地域とで同様の範囲の権利を取得しようとするときに、日本国特許庁の審査結果が出されてから
他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が新たに提示される頻度について、どのように感じていますか。

	より適切な引用文献がほとんど提示されない	より適切な引用文献がときどき提示される	より適切な引用文献がよく提示される	わからない／経験がない
① 米国特許商標庁（USPTO）	☐	☐	☐	☐
② 欧州特許庁（EPO）	☐	☐	☐	☐
③ 中国国家知識産権局（SIPO）	☐	☐	☐	☐
④ 韓国特許庁（KIPO）	☐	☐	☐	☐
⑤ 上記以外の主要な出願先国・地域	☐	☐	☐	

（国／地域名：　　　　　　　　　　　　）

その他、特許審査の質に関し、ご意見・ご要望がございましたら下記の記入欄に記入してください。
（上記１～８の項目で、「１：不満」又は「２：比較的不満」をご回答になった理由や、１～１１の項目に関する
追加のご意見・ご要望がございましたら、当欄に併せて記入してください）

【２】その他

その他、ご意見・ご要望がございましたら下記の記入欄に記入してください。

（自己や他者の個別案件に関するご意見や、本調査の様式等の本調査の手続き等に関するご意見等をご記入ください
なお、個別案件についてのご意見を記入する場合には、担当審査官へのフィードバック可否についても併せてご記入ください）

（記入欄）

【Ｂ票】　特定の国内出願における特許審査の質について

＊ **出願番号**　　　**（発明の名称）**

・上記出願の審査に対する評価に関し、下記【１】、【２】についてご回答ください。

【1】担当審査官にも具体的な課題を把握させて、審査の質を向上させるため、
回答内容を担当審査官にフィードバックさせていただきます。

☐ **担当審査官へのフィードバック不可**

【2】本件特許出願の特許審査の質についてどのように感じていますか。

満足	比較的満足	普通	比較的不満	不満
5	4	3	2	1
○	○	○	○	○

上記【２】にて「**５**」または「**４**」にチェックをされた場合、

満足した点を以下の項目から選択してください。また、具体的な理由を下記の記入欄に記入してください(複数可、任意)。

☐ 拒絶理由通知／拒絶査定の記載のわかりやすさの点
☐ 新規性・進歩性に関する判断が適切である点
☐ サーチ範囲・サーチ結果が適切である点
☐ 面接、電話等における審査官とのコミュニケーションの点
☐ その他（具体的な内容を下記記入欄に記入してください）

（自由記入欄）

上記【２】にて「**２**」または「**１**」にチェックをされた場合、

１．具体的にどの手続きに不満があったのかをⅠ欄に記載の手続きから選択してチェックし（複数可）、
２．チェックした各手続きのどの点に不満があったのかを以下のＡ～Ｉから選択してⅡ欄にチェックしてください（複数可）。

Ⅰ欄	A	B	C	D	E	F	G	H	I
☐ 最初の拒絶理由通知	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 最後の拒絶理由通知	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 特許査定						☐	☐	☐	☐
☐ 拒絶査定	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ａ：拒絶理由通知／拒絶査定の記載のわかりやすさの点
Ｂ：引用文献が必要以上に多く提示されている点
Ｃ：新規性・進歩性を欠いている理由についての判断の点　⇒　３－１．にもご回答ください
Ｄ：記載要件（第36条4項1号、第36条6項）を満たしていないとする理由についての判断の点　⇒　３－２．にもご回答ください
Ｅ：単一性違反（第37条）に関する判断の点
Ｆ：判断の均質性の点　⇒　３－３．にもご回答ください
Ｇ：サーチ範囲・サーチ結果の点　⇒　３－４．にもご回答ください
Ｈ：面接、電話等における審査官とのコミュニケーションの点☐
Ｉ：その他

３．上記２．でチェックした具体的理由について、下記３－１．～３－５．にご回答ください。

３－１．上記２．でＣ（新規性・進歩性）をチェックした場合には、その不満の内容を以下から選択してください。

- ☐ 引用文献の認定
- ☐ 一致点・相違点についての判断
- ☐ 組合せ・動機づけについての判断
- ☐ 下位請求項に対する判断
- ☐ その他

（自由記入欄）差し支えがなければ、不満と思われる具体的内容をご記入ください。

３－２．上記２．でＤ（記載要件）をチェックした場合には、その不満の内容を以下から選択してください。

- ☐ サポート要件に関する判断
- ☐ 実施可能要件に関する判断
- ☐ 明確性要件に関する判断
- ☐ プロダクト・バイ・プロセスクレーム（ＰＢＰ）に関する判断＊
- ☐ その他

＊上記チェックボックス欄にチェックする場合には、「明確性要件に関する判断」のチェックボックス欄には、チェックしないでください。

（自由記入欄）差し支えがなければ、不満と思われる具体的内容をご記入ください。

３－３．上記２．でＦ（判断の均質性）をチェックした場合には、その不満の内容を以下から選択してください。

- ☐ 同一技術分野内での判断の相違
- ☐ 異なる技術分野間での判断の相違
- ☐ 審査・審判間の判断の相違
- ☐ 他国特許庁との相違（国名：　　　　）
- ☐ その他

（自由記入欄）差し支えがなければ、不満と思われる具体的内容をご記入ください。

３－４．上記２．でＧ（サーチ）をチェックした場合には、その不満の内容を以下から選択してください。

- ☐ 外国特許文献の調査
- ☐ 非特許文献の調査
- ☐ 国内特許文献の調査
- ☐ 他国特許庁の調査結果との違い（国名：　　　　）
- ☐ その他

（自由記入欄）差し支えがなければ、不満と思われる具体的内容をご記入ください。

３－５．その他、追加のご意見・ご要望等がございましたら併せてご記入ください。
他の個別案件についてのご意見でも構いません。
（なお、他の個別案件についてのご意見を記入する場合には、担当審査官へのフィードバック可否についても併せてご記入ください）

（自由記入欄）

【Ｃ票】　　ＰＣＴ出願における国際調査等の質全般について

＊記名または無記名のいずれの回答を希望するかご回答ください。

○ 記名で回答する

○ 無記名で回答する

＊無記名での回答は、メールアドレス等により回答者が特定される場合であっても、無記名でいただいた回答として集計いたします。

お名前		ご連絡先（TEL）	

＊ご回答者のお名前、ご連絡先をご記入の上（記名でのご回答を希望された場合のみ）、
下記【１】～【２】の問いに**最近（１年程度）のご経験に基づいて**お答えください。
＊なお、ご回答いただいた内容につき、頂いた連絡先に確認の連絡をさせていただくことがございます。

【１】国際調査等（国際調査報告（様式210）・見解書（様式237）・予備審査（様式409））の質一般について

	満足 5	比較的満足 4	普通 3	比較的不満 2	不満 1
①最近（１年程度）の国際調査等の質全般についてどのように感じていますか。	○	○	○	○	○

②最近（１年程度）の国際調査等の質に関し、各項目１～１０の評価についてお答えください。	満足 5	比較的満足 4	普通 3	比較的不満 2	不満 1	わからない／経験がない
１．国際特許分類の精度	○	○	○	○	○	○
２．除外対象＊に関する判断 ＊数学の理論や事業活動、情報の単なる提示などにより調査の除外となったもの	○	○	○	○	○	○
３．単一性違反に関する判断	○	○	○	○	○	○
４．新規性・進歩性に関する判断	○	○	○	○	○	○
５．新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさ	○	○	○	○	○	○
６．記載不備等に関する判断	○	○	○	○	○	○
７．国際調査等における判断の均質性について	○	○	○	○	○	○
８．国際段階と国内段階との間での判断の一貫性について （日本国特許庁が行った国際調査等での判断と、日本国への国内移行後の判断との間で一貫性があるか）	○	○	○	○	○	○
９．サーチに関して						
９－１．国内特許文献の調査	○	○	○	○	○	○
９－２．外国特許文献の調査	○	○	○	○	○	○
９－３．非特許文献等の調査	○	○	○	○	○	○

１０．日本国特許庁を国際調査機関として指定し、国際調査機関としての見解を得てから各国の国内段階に移行したときに、他の国／地域の特許庁でより適切な引用文献が新たに提示される頻度について、どのように感じていますか。

	より適切な引用文献がほとんど提示されない	より適切な引用文献がときどき提示される	より適切な引用文献がよく提示される	わからない／経験がない
① 米国特許商標庁（USPTO）	☐	☐	☐	☐
② 欧州特許庁（EPO）	☐	☐	☐	☐
③ 中国国家知識産権局（SIPO）	☐	☐	☐	☐
④ 韓国特許庁（KIPO）	☐	☐	☐	☐
⑤ 上記以外の主要な出願先国・地域	☐	☐	☐	

（国／地域名：　　　　　　　　　　　　）

その他、特許審査の質に関し、ご意見・ご要望がございましたら下記の記入欄に記入してください。
（上記１～９の項目で、「１：不満」又は「２：比較的不満」をご回答になった理由や、１～１０の項目に関する追加のご意見・ご要望がありましたら、当欄に併せて記入してください）

【２】その他

その他、ご意見・ご要望がございましたら下記の記入欄に記入してください。
（自己や他者の個別案件に関するご意見、他国の国内段階での審査・調査結果に基づくご意見、本調査票の様式等の本調査の手続きに関するご意見等をご記入ください
なお、個別案件についてのご意見をご記入いただく場合には、担当審査官へのフィードバック可否についても併せてご記入ください）

（記入欄）

【Ｄ票】　特定のＰＣＴ出願における国際調査等の質について

＊ **国際出願番号**　　　　**（発明の名称）**

・上記出願の国際調査等（国際調査報告(様式210)・見解書(様式237)・予備審査(様式409)）に対する評価に関し、下記【１】、【２】についてご回答ください。

【１】担当審査官にも具体的な課題を把握させて、審査の質を向上させるため、回答内容を担当審査官にフィードバックさせていただきます。

☐ **担当審査官へのフィードバック不可**

【２】本件ＰＣＴ出願の国際審査等の質についてどのように感じていますか。

満足	比較的満足	普通	比較的不満	不満
5	4	3	2	1
○	○	○	○	○

上記【２】にて「**５**」または「**４**」にチェックをされた場合、
満足した点を以下の項目から選択してください。また、具体的な理由を下記の記入欄に記入してください（複数可、任意）。

☐ 国際調査報告・見解書等の記載のわかりやすさの点
☐ 新規性・進歩性に関する判断が適切である点
☐ サーチ範囲・サーチ結果が適切である点
☐ その他（具体的な内容を下記記入欄に記入してください）

（自由記入欄）

上記【２】にて「**２**」または「**１**」にチェックをされた場合、
１．具体的にどの手続きに不満があったのかをⅠ欄に記載の手続きから選択してチェックし（複数可）、
２．チェックした各手続きのどの点に不満があったのかを以下のＡ～Ｈから選択してⅡ欄にチェックしてください（複数可）。

Ⅰ欄	A	B	C	D	E	F	G	H
☐ 国際調査報告（様式210）／見解書（様式237）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 予備審査（様式409）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ａ：国際調査報告・見解書等の記載のわかりやすさの点
Ｂ：引用文献が必要以上に多く提示されている点
Ｃ：新規性・進歩性を欠いている理由についての判断の点
Ｄ：記載不備等と判断した理由についての判断の点
Ｅ：単一性違反に関する判断の点
Ｆ：判断の均質性の点
Ｇ：サーチ範囲・サーチ結果の点
Ｈ：その他

（Ａ～Ｄ）⇒　３－１．にもご回答ください
（Ｅ～Ｆ）⇒　３－２．にもご回答ください
（Ｇ～Ｈ）⇒　３－３．にもご回答ください

３．上記２．でチェックした具体的理由について、下記３－１．～３－４．にご回答ください。

３－１．上記２．でＣ（新規性・進歩性）をチェックした場合には、その不満の内容を以下から選択してください。

- ☐ 引用文献の認定
- ☐ 一致点・相違点についての判断
- ☐ 組合せ・動機づけについての判断
- ☐ 下位請求項に対する判断
- ☐ その他

（自由記入欄）差し支えがなければ、不満と思われる具体的内容をご記入ください。

３－２．上記２．でＦ（判断の均質性）をチェックした場合には、その不満の内容を以下から選択してください。

- ☐ 同一技術分野内での判断の相違
- ☐ 異なる技術分野間での判断の相違
- ☐ 国際段階と国内段階（日本国特許庁）との相違
- ☐ 国際段階と国内段階（他国特許庁）との相違
  （国名：　　　　　　）
- ☐ 国際段階（日本国特許庁）での相違
- ☐ その他

（自由記入欄）差し支えがなければ、不満と思われる具体的内容をご記入ください。

３－３．上記２．でＧ（サーチ）をチェックした場合には、その不満の内容を以下から選択してください。

- ☐ 外国特許文献の調査
- ☐ 非特許文献の調査
- ☐ 国内特許文献の調査
- ☐ 他国特許庁の調査結果との違い（国名：　　　　　　）
- ☐ その他

（自由記入欄）差し支えがなければ、不満と思われる具体的内容をご記入ください。

３－４．その他、追加のご意見・ご要望等がございましたら併せてご記入ください。
他の個別案件に対するご意見でも構いません。
（なお、個別案件についてのご意見を記入する場合には、担当審査官へのフィードバック可否についても併せてご記入ください）

（自由記入欄）

（英語版）

【Sheet A】 Overall Quality of Patent Examination on National Applications

When responding to the questionnaire, please indicate by checking the box below if you wish your name to be known to us; or if you wish to remain anonymous, i.e., you don't want your name to be known to us.

○ Wish your name to be known to us.
○ Wish to be anonymous.

*If you choose "Wish to be anonymous," your response will be handled anonymously. However, information such as your e-mail address might disclose your identity, which we will not make note of.

Your Name		E-mail address	

* If you choose "Wish your name to be known to us," please fill in the spaces above with your name and e-mail address. Please be advised that by providing your name and e-mail address, we may contact you if we have any question about your responses.
* We would appreciate it if you would kindly answer all the questions in [1] and [2] below, **according to your experience during the last one year or so**.

[1] Overall Quality of Patent Examination

	Satisfied 5	Somewhat Satisfied 4	Neutral 3	Somewhat Unsatisfied 2	Unsatisfied 1
1) Are you satisfied with the overall quality of patent examination at the JPO during the last one year or so?	○	○	○	○	○

2) Please evaluate the quality of JPO's patent examination regarding the following aspects 1-11 below.	Satisfied 5	Somewhat Satisfied 4	Neutral 3	Somewhat Unsatisfied 2	Unsatisfied 1	Not Sure/ No Opportunity
1. thorough and easy-to-understand description in notifications of reasons for refusal (except for any decisions of refusal)	○	○	○	○	○	○
2. thorough and easy-to-understand description in decision of refusal	○	○	○	○	○	○
3. proper application of the following legal wordings						
3-1. the main paragraph of Article 29 (1) (industrial applicability and judgement of whether the subject matter falls under the concept of "invention")	○	○	○	○	○	○
3-2. items of Article 29 (1) (novelty)	○	○	○	○	○	○
3-3. Article 29 (2) (inventive step)	○	○	○	○	○	○
3-4. Article 36 (4) (i) and Article 36 (6) (descriptive requirements for description and claims)	○	○	○	○	○	○
3-5. Article 37 (unity of invention)	○	○	○	○	○	○
3-6. Article 17-2 (3) through Article 17-2 (6) (amendment of description and claims etc.)	○	○	○	○	○	○
4. consistency of judgements among examiners	○	○	○	○	○	○
5. appropriateness of searches						
5-1. domestic patent literature searches	○	○	○	○	○	○
5-2. foreign patent literature searches	○	○	○	○	○	○
5-3. non-patent literature searches	○	○	○	○	○	○
6. level of examiners' expertise in technical details	○	○	○	○	○	○
7. communication with examiners such as face-to-face interviews and telephone conversations	○	○	○	○	○	○
8. scope of patent that was granted after examination (Is the scope of the patent that was granted sufficient in view of the contents of the application and prior art?)	○	○	○	○	○	○

9. If you have found any qualities that the JPO has, which exceed those of other patent offices, please check the categories below (multiple choices allowed).
If you have not found anything superior, then please check "nothing in particular".

- ☐ prior art searches
- ☐ thorough and easy-to-understand description in notifications of reasons for refusal
- ☐ judgement on novelty/inventive step
- ☐ examiners' understanding of technical details
- ☐ communication with examiners such as face-to-face interviews and telephone conversations
- ☐ others (fill in the space below)
- ☐ no opportunity for examination by the other Offices / not sure
- ☐ nothing in particular

comments for 9

10. If you have found other patent office(s), which have superior qualities compared to those of the JPO, please check the foreign patent office(s) below (multiple choices allowed). We also welcome your comment on which area the other offices are superior. If you did not feel that the other offices were superior, then please check "nothing in particular".

- ☐ United States Patent and Trademark Office (USPTO)
- ☐ European Patent Office (EPO)
- ☐ State Intellectual Property Office of the P.R.C. (SIPO)
- ☐ Korean Intellectual Property Office (KIPO)
- ☐ Other Office(s) (Which office(s) is it? Please fill in the space below.)
- ☐ no opportunity for examination by the other Offices / not sure
- ☐ nothing in particular

comments for 10

11. How often any proper cited document is newly presented in the other countries/regions after the JPO issued examination results on the application(s) aiming at obtaining the equivalent scope of patent rights at the JPO and in the other countries/regions?

	more proper document(s) are rarely cited	more proper document(s) are sometimes cited	more proper document(s) are often cited	no opportunity for examination at the other Office(s) / not sure
(1)United States Patent and Trademark Office (USPTO)	☐	☐	☐	☐
(2)European Patent Office (EPO)	☐	☐	☐	☐
(3)State Intellectual Property Office of the P.R.C. (SIPO)	☐	☐	☐	☐
(4)Korean Intellectual Property Office (KIPO)	☐	☐	☐	☐
(5)the countries/regions other than the above	☐	☐	☐	

(countries/regions:)

If you have any other comments on or requests for improving the quality of patent examination, please let us know in the space below. (If you chose “1: Unsatisfied” or “2: Somewhat Unsatisfied” in 1.-8. above, please comment on your reasons for being unsatisfied or somewhat unsatisfied. We also welcome your opinion / request related to the aspects 1.-11. above.)

[2]   Comments/Requests about any other aspects of the questionnaire

We would appreciate it if you would kindly give us any comments or requests you might have about any other aspects of the questionnaire. For example, this could include your opinions about your own or other users' specific application(s); or your comments could be about this Survey itself, such as the format, forms, wording. Please specify here whether you consent to giving your responses to the examiner(s) in charge as feedback, if you give any comments on any specific application.

comments

【Sheet B】Quality of Patent Examination on Specific National Applications

＊ **Application Number** [ ]   **(Title of the Invention)** [ ]

We would appreciate it if you would kindly answer the following questions in [1] and [2] below about the examination conducted on this specific patent application

[1] We would like to give your response to the examiner in charge as feedback for examination quality improvement.

☐ **I would NOT like to give my responses to the examiner(s) in charge as feedback.**

[2] Are you satisfied with the quality of patent examination on this application?

Satisfied	Somewhat Satisfied	Neutral	Somewhat Unsatisfied	Unsatisfied
5	4	3	2	1
○	○	○	○	○

If you chose "5: Satisfied" or "4: Somewhat Satisfied"
please check the reasons which you are satisfied/somewhat satisfied with among the choices provided below. (This is optional and multiple responses are possible.)

- ☐ thorough and easy-to-understand description in the notification(s) of reasons for refusal
- ☐ proper judgement on novelty/inventive step
- ☐ proper search scope/search results
- ☐ communication with examiners such as face-to-face interviews and telephone conversations
- ☐ others (Please write the details in the space below.)

comments

If you chose "2: Somewhat Unsatisfied" or "1: Unsatisfied" :

(1) Please check the procedures in **Column I** with which you are somewhat unsatisfied/unsatisfied (multiple choices allowed); and then

(2) check the options in **Column II** from A-I with which you are somewhat unsatisfied/unsatisfied (multiple choices allowed). The descriptions for A through I are listed below.

Column I	A	B	C	D	E	F	G	H	I
☐ first notification of reasons for refusal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ final notification of reasons for refusal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ decision to grant a patent						☐	☐	☐	☐
☐ decision of refusal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A : thorough and easy-to-understand description in the notification(s) of reasons for refusal / decision of refusal
B : excessive number of cited documents
C : judgement on lack of novelty/inventive step — ⇒ Please go on to 3-1.
D : judgement on lack of descriptive requirements (Article 36 (4) (i) and Article 36 (6)) — ⇒ Please go on to 3-2.
E : judgement regarding violation of requirements for unity (Article 37)
F : consistency of judgements among examiners — ⇒ Please go on to 3-3.
G : search scope/search results — ⇒ Please go on to 3-4.
H : communication with examiners such as face-to-face interviews and telephone conversations
I : others

(3) Please let us know the basis for your choice in 2. above.

3-1. If you chose “C: novelty/inventive step” in 2. above, please check the reasons with which you are unsatisfied.

- ☐ identification of cited document(s)
- ☐ judgement of identical features/differences
- ☐ judgement of combination/motivation
- ☐ judgement regarding dependent claim(s)
- ☐ others

comments (Please comment in the space below why you are unsatisfied with this case.)

3-2. If you chose “D: descriptive requirements,” in 2. above, please check the reasons with which you are unsatisfied.

- ☐ judgement regarding support requirements
- ☐ judgement regarding enablement requirements
- ☐ judgement regarding clarity requirements
- ☐ judgement regarding product-by-process (PBP) claims *
- ☐ others

*If you check this box for PBP claims, do not check the box "judgement regarding clarity requirements.”

comments (Please comment in the space below why you are unsatisfied with this case.)

3-3. If you chose “F: consistency of judgements” in 2. above, please check the reasons with which you are unsatisfied.

- ☐ difference in judgements in the same technical field
- ☐ difference in judgements among different technical fields
- ☐ difference in judgements between the examination division and the appeals and trials
- ☐ difference from the judgements at the office(s) other than the JPO (office name:)
- ☐ others

comments (Please comment in the space below why you are unsatisfied with this case.)

3-4. If you chose “G: searches” in 2. above, please check the reasons with which you are unsatisfied.

- ☐ foreign patent literature searches
- ☐ non-patent literature searches
- ☐ domestic patent literature searches
- ☐ difference from the search results at the office(s) other than the JPO (office name:)
- ☐ others

comments (Please comment in the space below why you are unsatisfied with this case.)

3-5. If you have any further comments or requests, please write them in the space below. You can also write comments/requests about other application(s).

(Please specify here whether you consent to giving your response to the examiner(s) in charge as feedback or not, if you give any comments on any other specific application.)

comments

【Sheet C】 Overall Quality of the International Search and International Preliminary Examination on PCT Applications

When responding to the questionnaire, please indicate by checking the box below if you wish your name to be known to us; or if you wish to remain anonymous, i.e., you don't want your name to be known to us.

- ○ Wish your name to be known to us.
- ○ Wish to be anonymous.

*If you choose "Wish to be anonymous," your response will be handled anonymously. However, information such as your e-mail address might disclose your identity, which we will not make note of.

Your Name		E-mail address	

* If you choose "Wish your name to be known to us," please fill in the spaces above with your name and e-mail address. Please be advised that by providing your name and e-mail address, we may contact you if we have any question about your responses.

* We would appreciate it if you would kindly answer all the questions in [1] and [2] below, **according to your experience during the last one year or so**.

[1] Overall Quality of the International Search and International Preliminary Examination including ISRs (Form PCT/ISA/210), WO/ISAs (Form PCT/ISA/237), and IPERs (Form PCT/ISA/409)

	Satisfied 5	Somewhat Satisfied 4	Neutral 3	Somewhat Unsatisfied 2	Unsatisfied 1
1) Are you satisfied with the overall quality of the International Search and International Preliminary Examination during the last one year or so?	○	○	○	○	○

2) Please evaluate the quality of the International Search and International Preliminary Examination at the JPO regarding the following aspects 1-11 below on a 5-point scale.	Satisfied 5	Somewhat Satisfied 4	Neutral 3	Somewhat Unsatisfied 2	Unsatisfied 1	Not sure / No Oppotrunity
1. IPC accuracy	○	○	○	○	○	○
2. judgement on excluded subject matter* from searches * excluded subject matter from searches falling under scientific and mathematical theories, methods of doing business, and mere presentations of information etc.	○	○	○	○	○	○
3. judgement on unity of invention	○	○	○	○	○	○
4. judgement on novelty/inventive step	○	○	○	○	○	○
5. reasoned statement regarding novelty/inventive step	○	○	○	○	○	○
6. judgement on descriptive defects	○	○	○	○	○	○
7. consistency of judgements in the international phase	○	○	○	○	○	○
8. consistency of judgements between the international phase and the national phase （consistency of judgements between the international phase at the JPO and the national phase at the JPO）	○	○	○	○	○	○
9. appropriateness of searches						
9-1. domestic patent literature searches	○	○	○	○	○	○
9-2. foreign patent literature searches	○	○	○	○	○	○
9-3. non-patent literature searches	○	○	○	○	○	○

10. How often any proper cited document is newly presented in the other countries/regions in the national phase, after the JPO issued the report as ISA?

	more proper document(s) are rarely cited	more proper document(s) are sometimes cited	more proper document(s) are often cited	no opportunity for examination at the other Office(s) / not sure
(1)United States Patent and Trademark Office (USPTO)	☐	☐	☐	☐
(2)European Patent Office (EPO)	☐	☐	☐	☐
(3)State Intellectual Property Office of the P.R.C. (SIPO)	☐	☐	☐	☐
(4)Korean Intellectual Property Office (KIPO)	☐	☐	☐	☐
(5)the countries/regions other than the above	☐	☐	☐	☐

(countries/regions:)

If you have any other comments on or requests for improving the quality of patent examination, please let us know in the space below. (If you chose “1: Unsatisfied” or “2: Somewhat Unsatisfied” in 1-9 above, please comment on your reasons for being unsatisfied or somewhat unsatisfied. We also welcome your opinion / request related to the aspects 1.-10. above.)

[2] Comments/Requests about any other aspects of the questionnaire

We would appreciate it if you would kindly give us any comments or requests you might have about any other aspects of the questionnaire. For example, this could include your opinions about your own or other users' specific application(s); or your comments could be about this Survey itself, such as the format, forms, wording. Please specify here whether you consent to giving your responses to the examiner(s) in charge as feedback, if you give any comments on any specific application.

comments

【Sheet D】 Quality of the International Search and International Preliminary Examination on Specific PCT Applications

＊ International Application Number

（Title of the Invention）

We would appreciate it if you would kindly answer the following questions [1] and [2] below about the examination conducted on this specific PCT application.

[1]We would like to give your response to the examiner in charge as feedback for examination quality improvement.
If you would NOT like to give your response(s) to the examiner(s) in charge as feedback, please check the box on the right side.

☐ **I would NOT like to give my responses to the examiner(s) in charge as feedback.**

[2] Are you satisfied with the quality of the International Search and International Preliminary Examination on this PCT application?

Satisfied	Somewhat Satisfied	Neutral	Somewhat Unsatisfied	Unsatisfied
5	4	3	2	1
○	○	○	○	○

<u>If you chose “5: Satisfied” or “4: Somewhat Satisfied”,</u>
please check the reasons which you are satisfied/somewhat satisfied with among the choices provided below.
(This is optional and multiple responses are possible.)

- ☐ thorough and easy-to-understand description in ISR, WO/ISA, and IPER
- ☐ proper judgement on novelty/inventive step
- ☐ proper search scope/search results
- ☐ others (Please write the details in the space below.)

comments

If you chose “2: Somewhat Unsatisfied” or “1: Unsatisfied” :

(1) Please check the procedures in **<u>Column I</u>** with which you are somewhat unsatisfied/unsatisfied (multiple choices allowed); and then

(2) check the options in **<u>Column II</u>** from A-H with which you are somewhat unsatisfied/unsatisfied (multiple choices allowed). The descriptions for A through H are listed below.

Column I	A	B	C	D	E	F	G	H
☐ ISR (Form PCT/ISA/210) or WO/ISA (Form PCT/ISA/237)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ IPER (Form PCT/ISA/409)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(Columns A–H form Column II.)

A : thorough and easy-to-understand description in ISRs / IPERs
B : excessive number of cited documents
C : judgement on lack of novelty / inventive step
D : judgement on descriptive deficiencies
E : judgement regarding violation of requirements for unity
F : consistency of judgements among examiners
G : search scope/search results
H : others

⇒ Please go on to 3-1.
⇒ Please go on to 3-2.
⇒ Please go on to 3-3.

(3) Please let us know the basis for your choice in 2. above.

3-1. If you chose “C: novelty/inventive step” in 2. above, please check the reasons with which you are unsatisfied.

- ☐ identification of cited document(s)
- ☐ judgement of identical features/differences
- ☐ judgement of combination/motivation
- ☐ judgement regarding dependent claim(s)
- ☐ others

comments (Please comment in the space below why you are unsatisfied with this case)

3-2. If you chose “F: consistency of judgements” in 2. above, please check the reasons below with which you are unsatisfied.

- ☐ difference in judgements in the same technical field
- ☐ difference in judgements among different technical fields
- ☐ difference in judgements between the international phase at the JPO and the national phase at the JPO
- ☐ difference in judgements between the international phase at the JPO and the national phase at office(s) other than the JPO (office name:)
- ☐ difference in judgements in the international phase at the JPO
- ☐ others

comments (Please comment in the space below why you are unsatisfied with this case)

3-3. If you chose “G: searches” in 2. above, please check the reasons below with which you are unsatisfied.

- ☐ foreign patent literature searches
- ☐ non-patent literature searches
- ☐ domestic patent literature searches
- ☐ difference from the search results at the office(s) other than the JPO (office name:)
- ☐ others

comments (Please comment in the space below why you are unsatisfied with this case)

3-4. If you have any further comments or requests, please write them in the space below. You can also write comments/requests about other application(s).

(Please specify here whether you consent to giving your response to the examiner(s) in charge as feedback or not, if you give any comments on any other specific application.)

Additional comments